* NOTICES *

JPO and NCIP1 are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

2.**** shows the word which can not be translated.

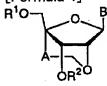
3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

(57) [Claim(s)]

[Claim 1] General formula (1)

[Formula 1]



Or it differs, the inside of [type, and R1 and R2 are the same -- R3 and R4 among the protective group of a hydrogen atom and a hydroxyl group, a phosphoric-acid radical, the protected phosphoric-acid radical, or a -P(R3) R4[type the same -- or -- differing -- a hydroxyl group, the protected hydroxyl group, a sulfhydryl group, and the protected sulfhydryl group -- The amino group, a carbon number 1 or four alkoxy groups, a carbon number 1, or four alkylthio groups, the amino group permuted by the carbon number 1 thru/or five cyano alkoxy groups or the carbon number 1 thru/or four alkyl groups is shown --] -- being shown -- A -- a carbon number 1 thru/or four alkylene groups are shown, and B shows the permutation pudding-9-IRU radical or permutation 2-oxo--pyrimidine-1-IRU radical which has the substituent chosen from a pudding-9-IRU radical, a 2-oxo-pyrimidine-1-IRU radical, or following alpha group.] The compound come out of and expressed, and its salt. (alpha group)

The amino group permuted by a hydroxyl group, the protected hydroxyl group, a carbon number 1 or four alkoxy groups, a sulfhydryl group, the protected sulfhydryl group, a carbon number 1 or four alkylthio groups, the amino group, the protected amino group, the carbon number 1, or four alkyl groups, a carbon number 1 or four alkyl groups, and a halogen atom.

[Claim 2] The compound according to claim 1 whose R1 is the methyl group permuted by 1 thru/or three aryl groups by which the aryl ring was permuted by the methyl group [which was permuted by a hydrogen atom, the aliphatic series acyl group, the aromatic series acyl group, 1, or three aryl groups], low-grade alkyl, and low-grade alkoxy ** halogen, or the cyano group, or a silvl radical, and its salt.

[Claim 3] The compound according to claim 1 whose R1 is a hydrogen atom, an acetyl group, benzoyl, benzyl, p-methoxybenzyl radical, a dimethoxytrityl radical, a mono-methoxytrityl radical, or a tert-butylphenylsilyl radical, and its salt.

[Claim 4] A compound and its salt given in claim 1 thru/or any 1 term of 3 whose R2 is the methyl group permuted by 1 thru/or three aryl groups by which the aryl ring was permuted by the methyl group [which was permuted by a hydrogen atom, the aliphatic series acyl group, the aromatic series acyl group, 1, or three aryl groups], low-grade alkyl, and low-grade alkoxy ** halogen, or the cyano group, a silyl radical, a phosphoroamidite radical, a phosphonyl group, a phosphoric-acid radical, or the protected phosphoric-acid radical.

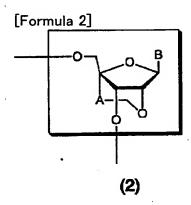
[Claim 5] A compound and its salt given in claim 1 thru/or any 1 term of 3 whose R2 is a hydrogen atom, an acetyl group, benzoyl, benzyl, p-methoxybenzyl radical, a tert-butylphenylsilyl radical, -P (OC2H4CN) (N(CH2 (CH3)) 2), -P (OCH3) (N(CH2 (CH3)) 2), a phosphonyl group, 2-chlorophenyl, or 4-chlorophenyl phosphoric-acid radical.

[Claim 6] A compound and its salt given in claim 1 thru/or any 1 term of 5 whose A is a methylene group.

[Claim 7] 6-aminopurine-9-IRU from which 6-aminopurine-9-IRU (namely, ADENINIRU) and the amino group were protected for B, 2,6-diaminopurine-9-IRU, 2-amino-6-chloropurine-9-IRU, 2amino-6-chloropurine-9-IRU, 2-amino-6-fluoro pudding-9-IRU from which the amino group was protected, 2-amino-6-fluoro pudding-9-IRU from which the amino group was protected, 2amino-6-BUROMO pudding-9-IRU from which 2-amino-6-BUROMO pudding-9-IRU and the amino group were protected, 2-amino-6-hydroxy pudding-9-IRU (namely, GUANINIRU), 2amino-6-hydroxy pudding-9-IRU from which the amino group was protected, 2-amino-6-hydroxy pudding-9-IRU from which the amino group and a hydroxyl group were protected, 6-amino-2methoxy pudding-9-IRU, 6-amino-2-chloropurine-9-IRU, 6-amino-2-fluoro pudding-9-IRU, 2, 6dimethoxy pudding-9-IRU, 2, 6-dichloro pudding-9-IRU, 6-mercaptopurine-9-IRU, 2-oxo--4amino-pyrimidine-1-IRU (namely, cytosinyl), 2-oxo-4-amino-pyrimidine-1-IRU from which the amino group was protected, 2-oxo--4-amino-5-fluoro-pyrimidine-1-IRU, 2-oxo--4-amino-5fluoro-pyrimidine-1-IRU from which the amino group was protected, 4-amino-2-oxo--5-chloropyrimidine-1-IRU, 2-oxo-4-methoxy-pyrimidine-1-IRU, 2-oxo-4-mercaptopyrimidine-1-IRU, 2-oxo--4-hydroxy-pyrimidine-1-IRU () Namely, URASHINIRU, 2-oxo--4-hydroxy-5methylpyrimidine-1-IRU () Namely, CHIMINIRU, 4-amino-5-methyl-2-oxo--pyrimidine-1-IRU () Namely, 4-amino -5 from which 5-methyl cytosinyl radical or the amino group was protected - A compound and its salt given in claim 1 thru/or any 1 term of 6 which is a methyl-2-oxo-pyrimidine-1-IRU radical.

[Claim 8] A compound and its salt given in claim 1 thru/or any 1 term of 6 whose B is 6-benzoyl aminopurine-9-IRU, ADENINIRU, 2-isobutyryl amino-6-hydroxy pudding-9-IRU, GUANINIRU, 2oxo--4-benzovlamino-pyrimidine-1-IRU, cytosinyl, 2-oxo--5-methyl-4-benzovlaminopyrimidine-1-IRU, 5-methyl cytosinyl, URASHINIRU, or a CHIMINIRU radical. [Claim 9] The compound chosen from the following group, and its salt;2'-O, 4'-C-ethylene guanosine, 2'-O and 4 -- 'a -C-ethylene adenosine, 3', 5' -- the - G O-benzyl -2 -- a '-O, 4'-C-ethylene-6-N-benzoyl adenosine -- 3' and 5' -- the - G O-benzyl -2 -- a '-O, 4'-Cethylene-2-N-isobutyryl guanosine -- 5'-O-dimethoxytrityl - 2' - O, a 4'-C-ethylene-6-Nbenzoyl adenosine, 5'-O-dimethoxytrityl - 2' - O, a 4'-C-ethylene-2-N-isobutyryl guanosine, 2' - O, a 4'-C-ethylene-2-N-isobutyryl guanosine, 2' - O, a 4'-C-ethylene-6-N-benzoyl adenosine, 5'-O-dimethoxytrityl-2 -- '-O, 4'-C-ethylene-6-N-benzoyl adenosine-3' -O-(2-cyano ethyl N and N-diisopropyl) phosphoroamidite 5'-O-dimethoxytrityl-2'-O -- 4 -- '-C-ethylene-2-Nisobutyryl guanosine-3' -- a -O-(2-cyano ethyl N, N-diisopropyl) phosphoroamidite 2 '-O, 4'-Cethylene uridine -- A 2 '-O, 4'-C-ethylene 5-methyl uridine, a 2 '-O, 4'-C-ethylene cytidine, 2'-O and 4 '-C-ethylene-5-methyl cytidine, 3', 5'- a G O-benzyl-2'-O, 4'-C-ethylene uridine -- A 5 '-O-dimethoxytrityl-2'-O, 4'-C-ethylene uridine, 3' and 5' - G O-benzyl -- a -2 '-O, 4'-Cethylene-5-methyl uridine -- A 5 '-O-dimethoxytrityl-2'-O, 4'-C-ethylene-5-methyl uridine, 3' and 5' -- the - G O-benzyl -2 -- a '-O, 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl cytidine -- 5'-Odimethoxytrityl - 2' - O, a 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl cytidine, 3' and 5 '- G O-benzyl -2' - O and a 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl-5-methyl cytidine -- 5'-O-dimethoxytrityl-2'-O, 4'-C -Ethylene-4-N-benzoyl-5-methyl cytidine, 2' - O, a 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl cytidine, 2 '-O, 4'-C - Ethylene-4-N-benzoyl-5-methyl cytidine, 5'-O-dimethoxytrityl-2' - O and 4'-Cethylene-uridine-3'-O-(2-cyano ethyl N and N-diisopropyl) phosphoroamidite, 5'-Odimethoxytrityl-2' - O and 4 '-C-ethylene-5-methyl uridine -3'-O-(2-cyano ethyl N and Ndiisopropyl) phosphoroamidite, 5'-O-dimethoxytrityl-2' - O and 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl cytidine-3'-O-(2-cyano ethyl N and N-diisopropyl) phosphoroamidite, And 5'-O-dimethoxytrityl-2' - O and 4'-C-ethylene-4-N-benzoyl-5-methyl cytidine-3'-O-(2-cyano ethyl N and Ndiisopropyl) phosphoroamidite.

[Claim 10] The following general formula (2)



[— the inside of a formula and A show a carbon number 1 thru/or four alkylene groups, and B shows the permutation pudding-9-IRU radical or permutation 2-oxo—pyrimidine-1-IRU radical which has the substituent chosen from a pudding-9-IRU radical, a 2-oxo—pyrimidine-1-IRU radical, or following alpha group.] The salt which comes out and is permitted in the structure expressed on 1 or the oligonucleotide analog contained two or more, and its pharmacology. (alpha group)

The amino group permuted by a hydroxyl group, the protected hydroxyl group, a carbon number 1 or four alkoxy groups, a sulfhydryl group, the protected sulfhydryl group, a carbon number 1 or four alkylthio groups, the amino group, the protected amino group, the carbon number 1, or four alkyl groups, a carbon number 1 or four alkyl groups, and a halogen atom.

[Claim 11] The salt permitted on the oligonucleotide analog according to claim 10 whose A is a methylene group, and its pharmacology.

[Claim 12] B 6-aminopurine-9-IRU (namely, ADENINIRU), [B] 6-aminopurine-9-IRU, 2,6diaminopurine-9-IRU from which the amino group was protected, 2-amino-6-chloropurine-9-IRU. 2-amino-6-chloropurine-9-IRU from which the amino group was protected, 2-amino-6fluoro pudding-9-IRU from which 2-amino-6-fluoro pudding-9-IRU and the amino group were protected, 2-amino-6-BUROMO pudding-9-IRU from which 2-amino-6-BUROMO pudding-9-IRU and the amino group were protected, 2-amino-6-hydroxy pudding-9-IRU (namely, GUANINIRU), 2-amino-6-hydroxy pudding-9-IRU from which the amino group was protected, 2amino-6-hydroxy pudding-9-IRU from which the amino group and a hydroxyl group were protected, 6-amino-2-methoxy pudding-9-IRU, 6-amino-2-chloropurine-9-IRU, 6-amino-2fluoro pudding-9-IRU, 2, 6-dimethoxy pudding-9-IRU, 2, 6-dichloro pudding-9-IRU, 6mercaptopurine-9-IRU, 2-oxo--4-amino-pyrimidine-1-IRU (namely, cytosinyl), 2-oxo--4-aminopyrimidine-1-IRU from which the amino group was protected, 2-oxo-4-amino-5-fluoropyrimidine-1-IRU, 2-oxo--4-amino-5-fluoro-pyrimidine-1-IRU from which the amino group was protected, 4-amino-2-oxo-5-chloro-pyrimidine-1-IRU, 2-oxo-4-methoxy-pyrimidine-1-IRU, 2-oxo-4-mercaptopyrimidine-1-IRU, 2-oxo-4-hydroxy-pyrimidine-1-IRU () Namely, URASHINIRU, 2-oxo--4-hydroxy-5-methylpyrimidine-1-IRU () Namely, CHIMINIRU, 4-amino-5methyl-2-oxo-pyrimidine-1-IRU () Namely, 4-amino -5 from which 5-methyl cytosinyl radical or the amino group was protected - Salt permitted on an oligonucleotide analog given in claim 10 thru/or any 1 term of 11 which is a methyl-2-oxo--pyrimidine-1-IRU radical, and its pharmacology.

[Claim 13] The salt permitted on an oligonucleotide analog given in claim 10 whose B is 6-benzoyl aminopurine-9-IRU, ADENINIRU, 2-isobutyryl amino-6-hydroxy pudding-9-IRU, GUANINIRU, 2-oxo-4-benzoylamino-pyrimidine-1-IRU, cytosinyl, 2-oxo-5-methyl-4-benzoylamino-pyrimidine-1-IRU, 5-methyl cytosinyl, URASHINIRU, or a CHIMINIRU radical thru/or any 1 term of 11, and its pharmacology.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)特許公報 (B2)

[11] 特許番号

特許第3420984号

(45) 発行日 平成15年6月30日(2003.6.30)

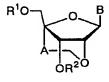
(P3420984) (24)登録日 平成15年4月18日(2003.4.18)

(51) Int. C1.7	識別記 号	FI
C 0 7 H	19/06	C 0 7 H 19/06
	19/16	19/16
	21/00	21/00
// A61K	31/712	A 6 1 K 31/712
	48/00	48/00
	請求項の数13	(全45頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2000-34560 (P2000-34560)	(73)特許権者 000001856
(==, ==,		三共株式会社
(22)出願日	平成12年2月14日 (2000. 2.14)	東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号
		(72) 発明者 金子 正勝
(65)公開番号	特開2000-297097 (P2000-297097A)	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式
(43)公開日	平成12年10月24日 (2000: 10.24)	会社内
審查請求日	平成13年6月5日(2001.6.5)	(72)発明者 森田 浩司
(31) 優先権主張	番号 特願平11-33863	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式
(32) 優先日	平成11年2月12日(1999.2.12)	会社内
(33) 優先権主張	国 日本(JP)	(72) 発明者 今西 武
		奈良県奈良市千代ヶ丘2丁目2-18
早期審査対象出	頭	(74)代理人 100081400
		弁理士 大野 彰夫 (外1名)
•	•	審査官 中木 亜希
		HERE JAMES TEACH
	•	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】新規ヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体

(57) 【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(1) 【化1】



(1)

[式中、R¹及びR²は、同一又は異なって、水素原子、水酸基の保護基、リン酸基、保護されたリン酸基又はーP(R³)R⁴[式中、R³及びR⁴は、同一又は異なって、水酸基、保護された水酸基、メルカプト基、保護されたメルカプト基、アミノ基、炭素数1乃至4個のアル

2

コキシ基、炭素数1万至4個のアルキルチオ基、炭素数1万至5個のシアノアルコキシ基又は炭素数1万至4個のアルキル基で置換されたアミノ基を示す]を示し、Aは、炭素数1万至4個のアルキレン基を示し、Bは、プリン-9-イル基、2-オキソーピリミジン-1-イル基で記憶をである。」で表わされる化合物及びその塩。(α群)

10 水酸基、

保護された水酸基、 炭素数 1 乃至 4 個のアルコキシ基、 メルカプト基、 保護されたメルカプト基、 炭素数 1 乃至 4 個のアルキルチオ基、 アミノ基、

保護されたアミノ基、

炭素数1乃至4個のアルキル基で置換されたアミノ基、 炭素数1乃至4個のアルキル基、及び、 ハロゲン原子。

【請求項2】R¹が、水素原子、脂肪族アシル基、芳香 族アシル基、1乃至3個のアリール基で置換されたメチ ル基、低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲン若しく はシアノ基でアリール環が置換された1万至3個のアリ ール基で置換されたメチル基、又は、シリル基である、 請求項1に記載の化合物及びその塩。

【請求項3】R¹が、水素原子、アセチル基、ベンゾイ ル基、ベンジル基、pーメトキシベンジル基、ジメトキ シトリチル基、モノメトキシトリチル基又はtert-ブチ ルジフェニルシリル基である、請求項1に記載の化合物 及びその塩。

【請求項4】R²が、水素原子、脂肪族アシル基、芳香 族アシル基、1乃至3個のアリール基で置換されたメチ ル基、低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲン若しく はシアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリ ール基で置換されたメチル基、シリル基、ホスホロアミ ダイト基、ホスホニル基、リン酸基又は保護されたリン 酸基である、請求項1乃至3の何れか1項に記載の化合 物及びその塩。

【請求項5】R²が、水素原子、アセチル基、ベンゾイ ル基、ペンジル基、pーメトキシベンジル基、tert-ブ チルジフェニルシリル基、-P(OC₂H₄CN)(N(CH(C は、2-クロロフェニル若しくは4-クロロフェニルリ ン酸基である、請求項1乃至3の何れか1項に記載の化 30 合物及びその塩。

【請求項6】Aが、メチレン基である、請求項1乃至5 の何れか1項に記載の化合物及びその塩。

【請求項7】 Bが、6-アミノプリン-9-イル(すな わち、アデニニル)、アミノ基が保護された6-アミノ プリンー9ーイル、2,6ージアミノプリンー9ーイ ル、2-アミノー6-クロロプリン-9-イル、アミノ 基が保護された2-アミノー6ークロロプリンー9ーイ ル、2-アミノー6-フルオロプリン-9-イル、アミ ノ基が保護された2-アミノー6-フルオロプリンー9 ーイル、2ーアミノー6ープロモプリンー9ーイル、ア ミノ基が保護された2ーアミノー6ープロモプリンー9 ーイル、2ーアミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル (すなわち、グアニニル)、アミノ基が保護された2-アミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル、アミノ基及 び水酸基が保護された2-アミノー6-ヒドロキシブリ ンー9ーイル、6ーアミノー2ーメトキシプリンー9ー イル、6ーアミノー2ークロロプリンー9ーイル、6ー アミノー2ーフルオロプリンー9ーイル、2,6ージメ トキシプリン-9-イル、2,6-ジクロロプリン-9 50 O,4'-C-エチレンウリジン、3',5'-ジ-O-ベン

ーイル、6ーメルカプトプリンー9ーイル、2ーオキソ - 4-アミノーピリミジン-1-イル(すなわち、シト シニル)、アミノ基が保護された2-オキソー4-アミ ノーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーアミノー 5-フルオローピリミジンー1-イル、アミノ基が保護 された2ーオキソー4ーアミノー5ーフルオローピリミ ジンー1ーイル、4ーアミノー2ーオキソー5ークロロ ーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメトキシー ピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメルカプトー 10 ピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーヒドロキシー ピリミジンー1ーイル(すなわち、ウラシニル)、2-オキソー4ーヒドロキシー5ーメチルピリミジンー1ー イル(すなわち、チミニル)、4ーアミノー5ーメチル -2-オキソーピリミジン-1-イル(すなわち、5-メチルシトシニル) 基又はアミノ基が保護された4-ア ミノー5ーメチルー2ーオキソーピリミジンー1ーイル 基である、請求項1乃至6の何れか1項に記載の化合物 及びその塩。

【請求項8】Bが、6ーベンゾイルアミノプリンー9ー イル、アデニニル、2-イソプチリルアミノー6-ヒド ロキシプリンー9ーイル、グアニニル、2ーオキソー4 ーベンゾイルアミノーピリミジンー1ーイル、シトシニ ル、2ーオキソー5ーメチルー4ーベンゾイルアミノー ピリミジン-1-イル、5-メチルシトシニル、ウラシ ニル又はチミニル基である、請求項1乃至6の何れか1 項に記載の化合物及びその塩。

【請求項9】下記群から選択される化合物及びその塩; 2'-O,4'-C-エチレングアノシン、2'-O,4'-C-エチレンアデノシン、3', 5'-ジ-O-ベンジルー 2'-O.4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシ ン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチ レン-2-N-イソブチリルグアノシン、5'-O-ジメト キシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-6-N-ベンゾ イルアデノシン、5′-0-ジメトキシトリチル-2′-O, 4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン、 2'-O.4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノ シン、2'-O,4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデ ノシン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エ チレン-6-N-ベンゾイルアデノシン-3'-O-(2-シ アノエチル N, Nージイソプロピル) ホスホロアミダ

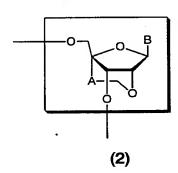
5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン-3'-O- (2-シアノ エチル N. Nージイソプロピル) ホスホロアミダイト 2'-O,4'-C-エチレンウリジン、2'-O,4'-C-エチレン5-メチルウリジン、2'-O,4'-C-エチレ ンシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-5-メチルシチ ジン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレンウリジン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-

5

ジル-2'-O.4'-C-エチレン-5-メチルウリジン、 5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレ ン-5-メチルウリジン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンソイルシチジ ン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エ チレン-4-N-ベンゾイルシチジン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル -5-メチルシチジン、5'-O-ジメトキシトリチルー 2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ペンゾイル-5-メチ ルシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾ イルシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベン ゾイル-5-メチルシチジン、5'-O-ジメトキシトリチル - 2'-O. 4'-C-エチレン-ウリジン-3'-O- (2-シ アノエチル N, N-ジイソプロピル) ホスホロアミダ レン-5-メチルウリジン-3'-〇- (2-シアノエチル N. Nージイソプロピル) ホスホロアミダイト、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン-3'-0-(2-シアノエチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト、及び、 5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルー5-メチルシチジン-3'-O-(2 - シアノエチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロア ミダイト。

【請求項10】下記一般式(2)

【化2】



[式中、 Aは、炭素数1万至4個のアルキレン基を示し、Bは、プリンー9ーイル基、2ーオキソーピリミジンー1ーイル基又は下記α群から選択される置換基を有する置換プリンー9ーイル基若しくは置換2ーオキソーピリミジンー1ーイル基を示す。]で表わされる構造を1又は2以上含有するオリゴヌクレオチド類縁体及びその薬理学上許容される塩。

(α群)

水酸基、

保護された水酸基、

炭素数1乃至4個のアルコキシ基、

メルカプト基、

保護されたメルカプト基、

炭素数1乃至4個のアルキルチオ基、

アミノ基、 保護されたアミノ基、

炭素数1乃至4個のアルキル基で置換されたアミノ基、 炭素数1乃至4個のアルキル基、及び、 ハロゲン原子。

6

【請求項11】Aがメチレン基である請求項10記載のオリゴヌクレオチド類縁体及びその薬理学上許容される塩。

【請求項12】Bが、Bが、6-アミノプリン-9-イ 10 ル (すなわち、アデニニル)、アミノ基が保護された6 ーアミノプリンー9ーイル、2,6ージアミノプリンー 9ーイル、2ーアミノー6ークロロプリンー9ーイル、 アミノ基が保護された2-アミノー6-クロロプリンー 9-イル、2-アミノー6-フルオロプリン-9-イ ル、アミノ基が保護された2-アミノー6-フルオロプ リンー9ーイル、2ーアミノー6ープロモプリンー9ー イル、アミノ基が保護された2-アミノー6-プロモプ リン-9-イル、2-アミノ-6-ヒドロキシプリン-9-イル(すなわち、グアニニル)、アミノ基が保護さ 20 れた2-アミノー6-ヒドロキシプリン-9-イル、ア ミノ基及び水酸基が保護された2-アミノー6-ヒドロ キシプリンー9ーイル、6ーアミノー2ーメトキシプリ ンー9ーイル、6ーアミノー2ークロロプリンー9ーイ ル、6-アミノー2-フルオロプリンー9-イル、2, 6-ジメトキシプリン-9-イル、2,6-ジクロロプ リンー 9 ーイル、6 ーメルカプトプリンー 9 ーイル、2 ーオキソー4ーアミノーピリミジン-1-イル(すなわ ち、シトシニル)、アミノ基が保護された2ーオキソー 4ーアミノーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ー 30 アミノー5ーフルオローピリミジンー1ーイル、アミノ 基が保護された2ーオキソー4ーアミノー5ーフルオロ ーピリミジンー1ーイル、4ーアミノー2ーオキソー5 ークロローピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメ トキシーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメル カプトーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーヒド ロキシーピリミジンー1ーイル(すなわち、ウラシニ ル)、2-オキソー4-ヒドロキシー5-メチルピリミ ジンー1ーイル(すなわち、チミニル)、4ーアミノー 5-メチルー2-オキソーピリミジン-1-イル(すな 40 わち、5-メチルシトシニル) 基又はアミノ基が保護さ れた4-アミノー5-メチルー2-オキソーピリミジン 1-イル基である、請求項10乃至11の何れか1項 に記載のオリゴヌクレオチド類縁体及びその薬理学上許 容される塩。

【請求項13】Bが、6ーベンゾイルアミノプリンー9ーイル、アデニニル、2ーイソブチリルアミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル、グアニニル、2ーオキソー4ーベンゾイルアミノーピリミジンー1ーイル、シトシニル、2ーオキソー5ーメチルー4ーベンゾイルアミノーピリミジンー1ーイル、5ーメチルシトシニル、ウラ

シニル又はチミニル基である請求項10乃至11の何れ か 1 項に記載のオリゴヌクレオチド類縁体及びその薬理 学上許容される塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、安定で優れたアン チセンス若しくはアンチジーン活性、又は、特定遺伝子 の検出薬 (プローブ) 若しくは増幅開始の為のプライマ ーとして優れた活性を有する、新規オリゴヌクレオチド 類縁体及びその製造中間体である新規ヌクレオシド類縁 10 体に関する。

[0002]

【従来の技術】優れたアンチセンス又はアンチジーン活 性を有し、かつ、生体内で安定な、オリゴヌクレオチド 類縁体は、有用な医薬として期待され、又、DNA又は mRNAとの安定な相補鎖形成能が高いオリゴヌクレオ チド類縁体は、特定遺伝子の検出薬又は増幅開始の為の プライマーとして有用である。

【0003】これに対し、天然型オリゴヌクレオチド は、血液中や細胞内に存在する各種ヌクレアーゼによ り、速やかに分解されてしまうことが知られている。 又、天然型オリゴヌクレオチドは、相補的塩基配列との 親和性による制限で、特定遺伝子の検出薬又は増幅開始 の為のプライマーとしては、充分な感度を持たない場合 もあった。

【0004】これらの欠点を克服すべく、種々の非天然 型のオリゴヌクレオチド類縁体が製造され、それらを医 薬又は特定遺伝子の検出薬等として、開発する試みがな されている。すなわち、例えば、オリゴヌクレオチドの ホスホジエステル結合内のリン原子と結合する酸素原子 30 を硫黄原子に置換したもの、該酸素原子をメチル基に置 換したもの、該酸素原子をホウ素原子に置換したもの、 オリゴヌクレオチドの糖部分や塩基部分を化学修飾した もの等が知られている。例えば、ISIS社は、ヒトサ イトメガロウイルス性網膜炎の治療薬として、チオエー ト型オリゴヌクレオチドであるISIS2922 (Vitrav ene)を開発し、米国で販売している。

【0005】しかしながら、上記の非天然型のオリゴヌ クレオチド類縁体における、アンチセンス又はアンチジ ーン活性の強さ、すなわち、DNA又はmRNAとの安 40 定な相補鎖形成能や、各種ヌクレアーゼに対する安定 性、生体内の各種蛋白質と非特異的に結合することによ る副作用の発現等を考慮すると、さらに優れた生体内で の安定性を有し、副作用の発現の少なく、かつ、相補鎖 形成能の高い非天然型のオリゴヌクレオチド類縁体が望 まれていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は、優れた アンチセンス又はアンチジーン活性を有し、生体内で安 定で、副作用の発現の少ない非天然型のオリゴヌクレオ 50 ピリミジンー1-イル基を示す。〕で表わされる構造を

チド類縁体につき、永年に亘り、鋭意研究を行なった。 その結果、分子内エーテル結合を有するオリゴヌクレオ チド類縁体及びヌクレオシド類縁体が、安定で優れたア ンチセンス若しくはアンチジーン医薬、特定遺伝子の検

出薬(プローブ)又は増幅開始の為のプライマー及びそ の製造中間体として有用であることを見出し、本発明を 完成した。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の新規ヌクレオシ ド類縁体は一般式(1)

[0008]

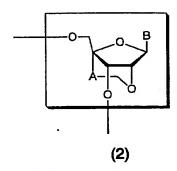
【化3】

20

[式中、R¹及びR²は、同一又は異なって、水素原子、 水酸基の保護基、リン酸基、保護されたリン酸基又は一 P (R³) R⁴ [式中、R³及びR⁴は、同一又は異なっ て、水酸基、保護された水酸基、メルカプト基、保護さ れたメルカプト基、アミノ基、炭素数1乃至4個のアル コキシ基、炭素数1乃至4個のアルキルチオ基、炭素数 1乃至5個のシアノアルコキシ基又は炭素数1乃至4個 のアルキル基で置換されたアミノ基を示す]を示し、A は、炭素数1乃至4個のアルキレン基を示し、Bは、プ リンー9-イル基、2-オキソービリミジン-1-イル 基又は下記α群から選択される置換基を有する置換プリ ンー9ーイル基若しくは置換2ーオキソーピリミジンー 1-イル基を示す。]で表わされる化合物及びその塩で あり、本発明のヌクレオチド類縁体は一般式 (2)

[0009]

【化4】



[式中、 Aは、炭素数 1 乃至 4 個のアルキレン基を示 し、Bは、プリンー9-イル基、2-オキソーピリミジ ン-1-イル基又は下記α群から選択される置換基を有 する置換プリンー9ーイル基若しくは置換2ーオキソー 1又は2以上有するオリゴヌクレオチド類縁体及びその 薬理学上許容される塩である。

(α群) 水酸基、保護された水酸基、炭素数1乃至4個のアルコキシ基、メルカプト基、保護されたメルカプト基、炭素数1乃至4個のアルキルチオ基、アミノ基、保護されたアミノ基、炭素数1乃至4個のアルキル基で置換されたアミノ基、炭素数1乃至4個のアルキル基、及び、ハロゲン原子。

【0010】上記一般式(1)又は(2)中、Aの「炭素数1乃至4個のアルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン基をあげることができ、好適には、メチレン基である。

【0011】上記一般式(1)又は(2)中、R¹及び R²の「水酸基の保護基」、並びにR³及びR⁴又はα群 の「保護された水酸基」の保護基とは、加水素分解、加 水分解、電気分解及び光分解のような化学的方法又は人 体内で加水分解等の生物学的方法により開裂し得る保護 基のことをいい、そのような保護基としては、例えば、 ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブ チリル、ペンタノイル、ピバロイル、バレリル、イソバ レリル、オクタノイル、ノナノイル、デカノイル、3-メチルノナノイル、8-メチルノナノイル、3-エチル オクタノイル、3, 7ージメチルオクタノイル、ウンデ カノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、テトラデカ ノイル、ペンタデカノイル、ヘキサデカノイル、1-メ チルペンタデカノイル、14-メチルペンタデカノイ ル、13.13-ジメチルテトラデカノイル、ヘプタデ カノイル、15-メチルヘキサデカノイル、オクタデカ ノイル、1-メチルヘプタデカノイル、ノナデカノイ ル、アイコサノイル及びヘナイコサノイルのようなアル キルカルボニル基、スクシノイル、グルタロイル、アジ ポイルのようなカルボキシ化アルキルカルボニル基、ク ロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロアセチ ル、トリフルオロアセチルのようなハロゲノ低級アルキ ルカルボニル基、メトキシアセチルのような低級アルコ キシ低級アルキルカルボニル基、(E)-2-メチル-2 ーブテノイルのような不飽和アルキルカルボニル基のよう うな「脂肪族アシル基」:ベンゾイル、αーナフトイ ル、β-ナフトイルのようなアリールカルポニル基、2 ープロモベンゾイル、4-クロロベンゾイルのようなハ 40 ロゲノアリールカルボニル基、2,4,6-トリメチル ベンゾイル、4-トルオイルのような低級アルキル化ア リールカルボニル基、4-アニソイルのような低級アル コキシ化アリールカルボニル基、2-カルボキシベンゾ イル、3-カルボキシベンゾイル、4-カルボキシベン ゾイルのようなカルボキシ化アリールカルボニル基、4 ーニトロベンゾイル、2ーニトロベンゾイルのようなニ トロ化アリールカルボニル基;2-(メトキシカルボニ ル) ベンゾイルのような低級アルコキシカルボニル化ア リールカルボニル基、4-フェニルベンゾイルのような

アリール化アリールカルボニル基のような「芳香族アシ ル基」;テトラヒドロピラン-2-イル、3-プロモテト ラヒドロピラン-2ーイル、4ーメトキシテトラヒドロピ ラン-4ーイル、テトラヒドロチオピラン-2ーイル、4ー メトキシテトラヒドロチオピラン-4ーイルのような「テ トラヒドロピラニル又はテトラヒドロチオピラニル 基」;テトラヒドロフラン-2-イル、テトラヒドロチオ フラン-2-イルのような「テトラヒドロフラニル又はテ トラヒドロチオフラニル基」:トリメチルシリル、トリ エチルシリル、イソプロピルジメチルシリル、t-ブチル ジメチルシリル、メチルジイソプロピルシリル、メチル ジ-tープチルシリル、トリイソプロピルシリルのような トリ低級アルキルシリル基、ジフェニルメチルシリル、 ジフェニルプチルシリル、ジフェニルイソプロピルシリ ル、フェニルジイソプロピルシリルのような1乃至2個 のアリール基で置換されたトリ低級アルキルシリル基の ような「シリル基」;メトキシメチル、1,1-ジメチ ルー1ーメトキシメチル、エトキシメチル、プロポキシ メチル、イソプロポキシメチル、ブトキシメチル、t-ブ トキシメチルのような「低級アルコキシメチル基」;2 ーメトキシエトキシメチルのような「低級アルコキシ化 低級アルコキシメチル基」; 2, 2, 2-トリクロロエ トキシメチル、ビス(2-クロロエトキシ) メチルのよう な「ハロゲノ低級アルコキシメチル」;1-エトキシエ チル、1-(イソプロポキシ)エチルのような「低級ア ルコキシ化エチル基」;2,2,2-トリクロロエチル のような「ハロゲン化エチル基」; ベンジル、αーナフ チルメチル、βーナフチルメチル、ジフェニルメチル、 トリフェニルメチル、αーナフチルジフェニルメチル、 9-アンスリルメチルのような「1乃至3個のアリール 基で置換されたメチル基」: 4-メチルベンジル、2. 4, 6-トリメチルペンジル、3, 4, 5ートリメチル ベンジル、4-メトキシベンジル、4-メトキシフェニ ルジフェニルメチル、4、4'ージメトキシトリフェニ ルメチル、2-ニトロベンジル、4-ニトロベンジル、 4-クロロベンジル、4-プロモベンジル、4-シアノ ベンジルのような「低級アルキル、低級アルコキシ、ハ ロゲン、シアノ基でアリール環が置換された1乃至3個 のアリール基で置換されたメチル基」;メトキシカルボ ニル、エトキシカルボニル、t-プトキシカルボニル、イ ソプトキシカルポニルのような「低級アルコキシカルポ ニル基」;2,2,2ートリクロロエトキシカルボニ ル、2-トリメチルシリルエトキシカルボニルのような 「ハロゲン又はトリ低級アルキルシリル基で置換された 低級アルコキシカルボニル基」;ビニルオキシカルボニ ル、アリールオキシカルボニルのような「アルケニルオ キシカルボニル基」:ベンジルオキシカルボニル、4-メトキシベンジルオキシカルポニル、3,4ージメトキ シベンジルオキシカルボニル、2-ニトロベンジルオキ

50 シカルボニル、4ーニトロベンジルオキシカルボニルの

10

ような1乃至2個の「低級アルコキシ又はニトロ基でア リール環が置換されていてもよいアラルキルオキシカル ボニル基」をあげることができ、R1及びR2の「水酸基 の保護基」においては、好適には、「脂肪族アシル 基」、「芳香族アシル基」、「1乃至3個のアリール基 で置換されたメチル基」、「低級アルキル、低級アルコ キシ、ハロゲン、シアノ基でアリール環が置換された1 乃至3個のアリール基で置換されたメチル基」又は「シ リル基」であり、さらに、好適には、アセチル基、ベン ゾイル基、ペンジル基、pーメトキシベンゾイル基、ジ 10 リフェニルメチル、1ーフェネチル、2ーフェネチル、 メトキシトリチル基、モノメトキシトリチル基又はtert -ブチルジフェニルシリル基であり、R³及びR⁴又はα 群の「保護された水酸基」においては、好適には、「脂 肪族アシル基」又は「芳香族アシル基」であり、さらに 好適には、ベンゾイル基である。

【0012】上記一般式(1)中、R¹及びR²の「保護 されたリン酸基」の保護基とは、加水素分解、加水分 解、電気分解及び光分解のような化学的方法又は人体内 で加水分解等の生物学的方法により開裂し得る保護基の ことをいい、そのような保護基としては、例えば、メチ ル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチ ル、イソブチル、sーブチル、tertーブチル、nーペン チル、イソペンチル、2-メチルブチル、ネオペンチ ル、1-エチルプロピル、n-ヘキシル、イソヘキシ ル、4-メチルペンチル、3-メチルペンチル、2-メ チルペンチル、1ーメチルペンチル、3,3ージメチル ブチル、2,2-ジメチルブチル、1,1-ジメチルブ チル、1,2ージメチルブチル、1,3ージメチルブチ ル、2,3ージメチルブチル、2-エチルブチルのよう な「低級アルキル基」;2ーシアノエチル、2ーシアノ - 1. 1 - ジメチルエチルのような「シアノ化低級アル キル基」;2-メチルジフェニルシリルエチル、2-ト リメチルシリルエチル、2-トリフェニルシリルエチル のような「シリル基で置換されたエチル基」; 2, 2, 2-トリクロロエチル、2,2,2-トリブロモエチ ル、2,2,2ートリフルオロエチル、2,2,2ート リクロロー1、1ージメチルエチルのような「ハロゲン 化低級アルキル基」:エテニル、1ープロペニル、2ー プロペニル、1-メチル-2-プロペニル、1-メチル -1-プロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルー2ープロペニル、2ーエチルー2ープロペニ ル、1-プテニル、2-プテニル、1-メチルー2-ブ テニル、1ーメチルー1ーブテニル、3ーメチルー2ー ブテニル、1-エチルー2-ブテニル、3-ブテニル、 1-メチルー3ープテニル、2-メチルー3ープテニ ル、1-エチルー3-ブテニル、1-ペンテニル、2-ペンテニル、1-メチル-2-ペンテニル、2-メチル -2ーペンテニル、3ーペンテニル、1ーメチルー3ー ペンテニル、2-メチル-3-ペンテニル、4-ペンテ ニル、1-メチル-4-ペンテニル、2-メチル-4- 50 -ブトキシ又はtert-ブトキシをあげることができ、好

12 ペンテニル、1-ヘキセニル、2-ヘキセニル、3-ヘ キセニル、4-ヘキセニル、5-ヘキセニルのような 「低級アルケニル基」;シクロプロピル、シクロブチ ル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチ ル、ノルポルニル、アダマンチルのような「シクロアル キル基」;2-シアノブテニルのような「シアノ化低級 アルケニル基」;ベンジル、 α ーナフチルメチル、 β ー ナフチルメチル、インデニルメチル、フェナンスレニル メチル、アントラセニルメチル、ジフェニルメチル、ト 1ーナフチルエチル、2ーナフチルエチル、1ーフェニ ルプロピル、2-フェニルプロピル、3-フェニルプロ ピル、1ーナフチルプロピル、2ーナフチルプロピル、 3ーナフチルプロピル、1ーフェニルブチル、2-フェ ニルブチル、3-フェニルブチル、4-フェニルブチ ル、1ーナフチルプチル、2ーナフチルブチル、3ーナ フチルブチル、4ーナフチルブチル、1-フェニルペン チル、2-フェニルペンチル、3-フェニルペンチル、 4-フェニルペンチル、5-フェニルペンチル、1-ナ フチルペンチル、2ーナフチルペンチル、3ーナフチル ペンチル、4ーナフチルペンチル、5ーナフチルペンチ ル、1-フェニルヘキシル、2-フェニルヘキシル、3 ーフェニルヘキシル、4ーフェニルヘキシル、5ーフェ ニルヘキシル、6-フェニルヘキシル、1-ナフチルヘ キシル、2-ナフチルヘキシル、3-ナフチルヘキシ ル、4-ナフチルヘキシル、5-ナフチルヘキシル、6 -ナフチルヘキシルのような「アラルキル基」;4-ク ロロベンジル、2-(4-ニトロフェニル)エチル、o ^ ーニトロペンジル、4ーニトロペンジル、2、4ージニ トロベンジル、4-クロロー2-ニトロベンジルのよう な「ニトロ基、ハロゲン原子でアリール環が置換された アラルキル基」:フェニル、インデニル、ナフチル、フ ェナンスレニル、アントラセニルのような「アリール 基」;2-メチルフェニル、2,6-ジメチルフェニ ル、2-クロロフェニル、4-クロロフェニル、2,4 ージクロロフェニル、2,5ージクロロフェニル、2ー プロモフェニル、4-ニトロフェニル、4-クロロー2 ーニトロフェニルのような「低級アルキル基、ハロゲン 原子、ニトロ基で置換されたアリール基」を挙げる事が でき、好適には、「低級アルキル基」、「シアノ基で置 換された低級アルキル基」、「アラルキル基」又は「ニ トロ基、ハロゲン原子でアリール環が置換されたアラル キル基」であり、さらに好適には、2-シアノエチル 基、2,2,2ートリクロロエチル基又はベンジル基で

【0013】上記一般式(1)又は(2)中、R³及び R4又はα群の「炭素数1乃至4個のアルコキシ基」と しては、例えば、メトキシ、エトキシ、nープロポキ シ、イソプロポキシ、nーブトキシ、イソブトキシ、s

ある。

14

適には、メトキシ又はエトキシ基である。

【0014】上記一般式(1)又は(2)中、R³及びR⁴又はα群の「保護されたメルカプト基」の保護基としては、例えば、上記水酸基の保護基としてあげたものの他、メチルチオ、エチルチオ、tertーブチルチオのようなアルキルチオ基、ベンジルチオのようなアリールチオ基等の「ジスルフィドを形成する基」をあげることができ、好適には、「脂肪族アシル基」又は「芳香族アシル基」であり、さらに、好適には、ベンゾイル基である。

【0015】上記一般式(1)又は(2)中、R³及び R4又はα群の「炭素数1乃至4個のアルキルチオ基」 としては、例えば、メチルチオ、エチルチオ、プロピル チオ、イソプロピルチオ、プチルチオ、イソプチルチ オ、sープチルチオ、tertープチルチオをあげることが でき、好適には、メチルチオ又はエチルチオ基である。 【0016】上記一般式(1)又は(2)中、R³及び R⁴又はα群の「保護されたアミノ基」の保護基として は、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチ リル、イソブチリル、ペンタノイル、ピバロイル、バレ リル、イソバレリル、オクタノイル、ノナノイル、デカ ノイル、3ーメチルノナノイル、8ーメチルノナノイ ル、3-エチルオクタノイル、3,7-ジメチルオクタ ノイル、ウンデカノイル、ドデカノイル、トリデカノイ ル、テトラデカノイル、ペンタデカノイル、ヘキサデカ ノイル、1ーメチルペンタデカノイル、14ーメチルペ ンタデカノイル、13,13-ジメチルテトラデカノイ ル、ヘプタデカノイル、15-メチルヘキサデカノイ ル、オクタデカノイル、1ーメチルヘプタデカノイル、 ノナデカノイル、アイコサノイル及びヘナイコサノイル のようなアルキルカルボニル基、スクシノイル、グルタ ロイル、アジポイルのようなカルボキシ化アルキルカル ボニル基、クロロアセチル、ジクロロアセチル、トリク ロロアセチル、トリフルオロアセチルのようなハロゲノ 低級アルキルカルボニル基、メトキシアセチルのような 低級アルコキシ低級アルキルカルポニル基、(E)-2 -メチル-2-プテノイルのような不飽和アルキルカルボ ニル基等の「脂肪族アシル基」: ベンゾイル、αーナフ トイル、βーナフトイルのようなアリールカルボニル 基、2-プロモベンゾイル、4-クロロベンゾイルのよ うなハロゲノアリールカルボニル基、2,4,6-トリ メチルベンゾイル、4ートルオイルのような低級アルキ ル化アリールカルボニル基、4-アニソイルのような低 級アルコキシ化アリールカルボニル基、2-カルポキシ ベンゾイル、3-カルボキシベンゾイル、4-カルボキ シベンゾイルのようなカルボキシ化アリールカルボニル 基、4-ニトロベンゾイル、2-ニトロベンゾイルのよ うなニトロ化アリールカルポニル基:2-(メトキシカ ルボニル). ベンゾイルのような低級アルコキシカルボニ ル化アリールカルボニル基、4-フェニルベンゾイルの

ようなアリール化アリールカルボニル基等の「芳香族ア シル基」;メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、 t-ブトキシカルボニル、イソプトキシカルボニルのよう な「低級アルコキシカルボニル基」;2,2,2-トリ クロロエトキシカルポニル、2ートリメチルシリルエト キシカルボニルのような「ハロゲン又はトリ低級アルキ ルシリル基で置換された低級アルコキシカルボニル 基」;ビニルオキシカルポニル、アリールオキシカルボ ニルのような「アルケニルオキシカルボニル基」;ベン 10 ジルオキシカルボニル、4-メトキシベンジルオキシカ ルポニル、3.4-ジメトキシベンジルオキシカルボニ ル、2-ニトロベンジルオキシカルボニル、4-ニトロ ベンジルオキシカルボニルのような1乃至2個の「低級 アルコキシ又はニトロ基でアリール環が置換されていて もよいアラルキルオキシカルポニル基」をあげることが でき、好適には、「脂肪族アシル基」又は「芳香族アシ ル基」であり、さらに好適には、ベンゾイル基である。 【0017】上記一般式(1)又は(2)中、R³及び R⁴又はα群の「炭素数1乃至4個のアルキル基で置換 されたアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エ チルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミノ、ブ チルアミノ、イソブチルアミノ、sーブチルアミノ、te rtーブチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、 ジプロピルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジブチルア ミノ、ジイソブチルアミノ、ジ (s-ブチル)アミノ、 ジ(tertーブチル)アミノをあげることができ、好適に は、メチルアミノ、エチルアミノ、ジメチルアミノ、ジ エチルアミノまたはジイソプロピルアミノ基である。

【0018】上記一般式(1)中、R³及びR⁴の「炭素数1乃至5個のシアノアルコキシ基」とは、上記「炭素数1乃至4個のアルコキシ基」にシアノ基が置換した基をいい、その様な基としては、例えば、例えば、シアノメトキシ、2ーシアノエトキシ、3ーシアノフロボキシ、4ーシアノブトキシ、3ーシアノー2メチルプロボキシ、又は1ーシアノメチルー1、1ージメチルメトキシをあげることができ、好適には、2ーシアノエトキシ基である。

【0019】上記一般式(1)又は(2)中、α群の「炭素数1乃至4個のアルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tertーブチルをあげることができ、好適には、メチル又はエチル基である。

【0020】上記一般式(1)又は(2)中、 α 群の「ハロゲン原子」としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子をあげることができ、好適には、フッ素原子又は塩素原子である。

【0021】上記一般式(1)又は(2)中、Bの「プリンー9ーイル基」及び「置換プリンー9ーイル基」全体で、好適な基は、6ーアミノプリンー9ーイル(すなわち、アデニニル)、アミノ基が保護された6ーアミノ

16

プリンー9ーイル、2,6ージアミノプリンー9ーイ ル、2-アミノー6-クロロプリン-9-イル、アミノ 基が保護された2-アミノー6-クロロプリン-9-イ ル、2-アミノー6-フルオロプリン-9-イル、アミ ノ基が保護された2ーアミノー6ーフルオロプリンー9 ーイル、2-アミノー6-ブロモプリンー9-イル、ア ミノ基が保護された2-アミノー6-プロモプリンー9 ーイル、2ーアミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル (すなわち、グアニニル)、アミノ基が保護された2-アミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル、アミノ基及 び水酸基が保護された2ーアミノー6ーヒドロキシプリ ンー9ーイル、6ーアミノー2ーメトキシプリンー9ー イル、6ーアミノー2ークロロプリンー9ーイル、6ー アミノー2ーフルオロプリンー9ーイル、2,6ージメ トキシプリンー9ーイル、2,6ージクロロプリンー9 -イル又は6-メルカプトプリン-9-イル基であり、 さらに好適には、6-ベンゾイルアミノプリン-9-イ ル、アデニニル、2-イソブチリルアミノー6-ヒドロ キシプリンー9-イル又はグアニニル基である。

【0022】上記一般式(1)又は(2)中、Bの「2 ーオキソーピリミジンー1ーイル基」及び「置換2ーオ キソーピリミジンー1ーイル基」全体で、好適な基は、 2-オキソー4-アミノーピリミジン-1-イル(すな わち、シトシニル)、アミノ基が保護された2ーオキソ -4-アミノービリミジン-1-イル、2-オキソー4 ーアミノー5ーフルオローピリミジンー1ーイル、アミ ノ基が保護された2ーオキソー4ーアミノー5ーフルオ ローピリミジンー1ーイル、4ーアミノー2ーオキソー 5-クロローピリミジンー1-イル、2-オキソー4-メトキシーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメ ルカプトーピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーヒ ドロキシーピリミジンー1ーイル(すなわち、ウラシニ ル)、2-オキソー4-ヒドロキシー5-メチルピリミ ジン-1-イル(すなわち、チミニル)又は4-アミノ -5-メチル-2-オキソーピリミジン-1-イル(す なわち、5-メチルシトシニル)基であり、さらに好適 には、2-オキソー4-ベンゾイルアミノーピリミジン -1-イル、シトシニル、チミニル、ウラシニル、2-オキソー4ーベンゾイルアミノー5ーメチルーピリミジ ンー1ーイル、又は5ーメチルシトシニル基である。

【0023】「ヌクレオシド類縁体」とは、プリン又は ピリミジン塩基と糖が結合した「ヌクレオシド」のう ち、非天然型のものを言う。

【0024】「オリゴヌクレオチド類縁体」とは、同一 又は異なる上記「ヌクレオシド」がリン酸ジエステル結 合で2乃至50個結合した「オリゴヌクレオチド」の非 天然型誘導体をいい、そのような類縁体としては、好適 には、糖部分が修飾された糖誘導体;リン酸ジエステル 結合部分がチオエート化されたチオエート誘導体;末端 のリン酸部分がエステル化されたエステル体;プリン塩 50

基上のアミノ基がアミド化されたアミド体を挙げることができ、さらに好適には、糖部分が修飾された糖誘導体及びリン酸ジエステル結合部分がチオエート化されたチオエート誘導体を挙げる事が出来る。

【0025】「その塩」とは、本発明の化合物(1) は、塩にすることができるので、その塩をいい、そのよ うな塩としては、好適にはナトリウム塩、カリウム塩、 リチウム塩のようなアルカリ金属塩、カルシウム塩、マ グネシウム塩のようなアルカリ土類金属塩、アルミニウ ム塩、鉄塩、亜鉛塩、銅塩、ニッケル塩、コバルト塩等 の金属塩:アンモニウム塩のような無機塩、t-オクチ ルアミン塩、ジベンジルアミン塩、モルホリン塩、グル コサミン塩、フェニルグリシンアルキルエステル塩、エ チレンジアミン塩、Nーメチルグルカミン塩、グアニジ ン塩、ジエチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ジシク ロヘキシルアミン塩、N, N'ージベンジルエチレンジ アミン塩、クロロプロカイン塩、プロカイン塩、ジエタ ·ノールアミン塩、Nーベンジルーフェネチルアミン塩、 ピペラジン塩、テトラメチルアンモニウム塩、トリス (ヒドロキシメチル) アミノメタン塩のような有機塩等 のアミン塩;弗化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、沃 化水素酸塩のようなハロゲン原子化水素酸塩、硝酸塩、 過塩素酸塩、硫酸塩、燐酸塩等の無機酸塩:メタンスル ホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンス ルホン酸塩のような低級アルカンスルホン酸塩、ベンゼ ンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩のようなアリ ールスルホン酸塩、酢酸塩、りんご酸塩、フマール酸 塩、コハク酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、蓚酸塩、マレ イン酸塩等の有機酸塩;及び、グリシン塩、リジン塩、 アルギニン塩、オルニチン塩、グルタミン酸塩、アスパ ラギン酸塩のようなアミノ酸塩を挙げることができる。 【0026】「その薬理上許容される塩」とは、本発明 の修飾オリゴヌクレオチド又はポリヌクレオチド類縁体 は、塩にすることができるので、その塩をいい、そのよ うな塩としては、好適にはナトリウム塩、カリウム塩、 リチウム塩のようなアルカリ金属塩、カルシウム塩、マ グネシウム塩のようなアルカリ土類金属塩、アルミニウ ム塩、鉄塩、亜鉛塩、銅塩、ニッケル塩、コバルト塩等 の金属塩;アンモニウム塩のような無機塩、 tーオクチ 40 ルアミン塩、ジベンジルアミン塩、モルホリン塩、グル コサミン塩、フェニルグリシンアルキルエステル塩、エ チレンジアミン塩、Nーメチルグルカミン塩、グアニジ ン塩、ジエチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ジシク ロヘキシルアミン塩、N, N'ージベンジルエチレンジ アミン塩、クロロプロカイン塩、プロカイン塩、ジエタ ノールアミン塩、Nーベンジルーフェネチルアミン塩、 ピペラジン塩、テトラメチルアンモニウム塩、トリス (ヒドロキシメチル) アミノメタン塩のような有機塩等 のアミン塩;弗化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、沃 化水素酸塩のようなハロゲン原子化水素酸塩、硝酸塩、

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イソプチリルグアノシン-3'-O-(2-シアノ エチル N, Nージイソプロピル) ホスホロアミダイト 2'-O,4'-C-エチレンウリジン、2'-O,4'-C-エチレン5-メチルウリジン、2'-O,4'-C-エチレ ンシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-5-メチルシチ ジン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレンウリジン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレンウリジン、3',5'-ジ-O-ベン ジル-2'-O,4'-C-エチレン-5-メチルウリジン、 5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレ ン-5-メチルウリジン、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジ ン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エ チレン-4-N-ベンゾイルシチジン、31,51-ジ-O-ベンジル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル -5-メチルシチジン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル-5-メチ ルシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾ イルシチジン、2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベン ゾイル-5-メチルシチジン、5-0-ジメトキシトリチル - 2'-O. 4'-C-エチレン-ウリジン - 3'-O - (2 - シ アノエチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロアミダ イト、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチ レン-5-メチルウリジン-3'-〇-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン-3'-0-(2-シアノエチル N. Nージイソプロピル) ホスホロアミダイト、及び、 5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルー5-メチルシチジン-3'-O- (2 - シアノエチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロア ミダイト。

19

又は2以上含有するオリゴヌクレオチド類縁体及びその 薬理学上許容される塩のうち、好適なものとしては、 (8). Aが、メチレン基であるオリゴヌクレオチド類縁 体及びその薬理学上許容される塩、(9)Bが、6-ア ミノプリン-9-イル(すなわち、アデニニル)、アミ ノ基が保護された6-アミノプリン-9-イル、2,6 ージアミノプリンー9ーイル、2ーアミノー6ークロロ プリンー9ーイル、アミノ基が保護された2ーアミノー 6-クロロプリン-9-イル、2-アミノー6-フルオ ロプリンー9ーイル、アミノ基が保護された2ーアミノ -6-フルオロプリン-9-イル、2-アミノー6-ブ ロモプリンー9ーイル、アミノ基が保護された2ーアミ ノー6ープロモプリンー9ーイル、2ーアミノー6ーヒ **¨ドロキシプリンー9-イル(すなわち、グアニニル)、** アミノ基が保護された2-アミノー6-ヒドロキシブリ

【0029】本発明の一般式(2)で表される構造を1

ミノー6ーヒドロキシプリンー9ーイル、6ーアミノー 2-メトキシプリン-9-イル、6-アミノ-2-クロ ロプリン-9-イル、6-アミノ-2-フルオロプリン -9-4ル、2, 6-5メトキシプリン-9-4ル、 2. 6-ジクロロプリンー9-イル、6-メルカプトプ リンー9ーイル、2ーオキソー4ーアミノーピリミジン - 1 - イル(すなわち、シトシニル)、アミノ基が保護 された2-オキソー4-アミノーピリミジン-1-イ ル、2-オキソー4-アミノー5-フルオローピリミジ 10 ンー1ーイル、アミノ基が保護された2ーオキソー4ー アミノー5ーフルオローピリミジンー1ーイル、4ーア ミノー2ーオキソー5ークロローピリミジンー1ーイ ル、2-オキソー4-メトキシーピリミジン-1-イ ル、2-オキソー4-メルカプトーピリミジン-1-イ ル、2-オキソー4-ヒドロキシーピリミジン-1-イ ル(すなわち、ウラシニル)、2-オキソー4-ヒドロ キシー5ーメチルピリミジンー1ーイル(すなわち、チ ミニル)、4-アミノー5-メチルー2-オキソーピリ ミジンー1ーイル(すなわち、5ーメチルシトシニル) 20 基又はアミノ基が保護された4-アミノー5-メチルー 2-オキソーピリミジン-1-イル基であるオリゴヌク ·レオチド類縁体及びその薬理学上許容される塩、(1 0) Bが、6ーベンゾイルアミノプリン-9ーイル、ア デニニル、2-イソブチリルアミノー6-ヒドロキシプ リンー9ーイル、グアニニル、2ーオキソー4ーベンゾ イルアミノーピリミジンー1ーイル、シトシニル、2ー オキソー5ーメチルー4ーベンゾイルアミノーピリミジ ンー1ーイル、5ーメチルシトシニル、ウラシニル又は チミニル基であるオリゴヌクレオチド類縁体及びその薬 30 理学上許容される塩をあげることができる。

20

【0030】又、上記(9)乃至(10)は、番号が大 きくなるに従って、より好適なオリゴヌクレオチド類縁 体を示し、一般式(2)において、Aを(8)から任意 に選択し、Bを(9)乃至(10)から任意に選択し、 又、これらを任意に組み合わせて得られたオリゴヌクレ オチド類縁体およびその薬理学上許容される塩も好適で

【0031】本発明の上記式(1)の化合物に包含され る、具体的な化合物を表1及び表2に例示する。但し、 40 本発明の化合物は、これらに限定されるものではない。 【0032】表1及び表2において、Meは、メチル基 を示し、Bnは、ベンジル基を示し、Bzは、ベンゾイ ル基を示し、PMBは、p-メトキシベンジル基を示 し、Trは、トリフェニルメチル基を示し、MMTr は、4-メトキシトリフェニルメチル(モノメトキシト リチル) 基を示し、DMTrは、4,4'ージメトキシ トリフェニルメチル (ジメトキシトリチル) 基を示し、 TMTrは、4, 4', 4'' ートリメトキシトリフェ ニルメチル (トリメトキシトリチル) 基を示し、TMS ンー 9 ーイル、アミノ基及び水酸基が保護された 2 ーア 50 は、トリメチルシリル基を示し、TBDMSは、tertー

過塩素酸塩、硫酸塩、燐酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩のような低級アルカンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩のようなアリールスルホン酸塩、酢酸塩、りんご酸塩、フマール酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、蓚酸塩、マレイン酸塩等の有機酸塩;及び、グリシン塩、リジン塩、アルギニン塩、オルニチン塩、グルタミン酸塩、アスパラギン酸塩のようなアミノ酸塩を挙げることができる。【0027】本発明の化合物(1)及びその塩のうち、好適な化合物としては、

(1) R¹が、水素原子、脂肪族アシル基、芳香族アシル基、1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基、低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲン若しくはシアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基、又は、シリル基である化合物及びその塩

(2) R¹が、水素原子、アセチル基、ベンゾイル基、ベンジル基、pーメトキシベンジル基、ジメトキシトリチル基又はtert-ブチルジフェニルシリル基である化合物及びその塩、

(3) R²が、水素原子、脂肪族アシル基、芳香族アシル基、1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基、低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲン若しくはシアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基、シリル基、ホスホロアミダイト基、ホスホニル基、リン酸基又は保護されたリン酸基である化合物及びその塩、

(4) R^2 が、水素原子、アセチル基、ベンゾイル基、ベンジル基、p-メトキシベンジル基、tert-ブチルジフェニルシリル基、 $-P(OC_2H_4CN)(N(CH(CH_3)_2)_2)$ 、 $-P(OC_3H_3)(N(CH(CH_3)_2)_2)$ 、ホスホニル基、又は、2-クロロフェニル若しくは4-クロロフェニルリン酸基である化合物及びその塩、

(5) Aが、メチレン基である化合物及びその塩、

 18

2-フルオロプリン-9-イル、2,6-ジメトキシプ リンー9ーイル、2.6ージクロロプリンー9ーイル、 6-メルカプトプリン-9-イル、2-オキソー4-ア ミノーピリミジンー 1 ーイル (すなわち、シトシニー ル)、アミノ基が保護された2-オキソー4-アミノー ピリミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーアミノー5ー フルオローピリミジンー1ーイル、アミノ基が保護され た2-オキソー4-アミノー5-フルオローピリミジン -1-イル、4-アミノー2-オキソー5-クロローピ 10 リミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメトキシーピリ ミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーメルカプトーピリ ミジンー1ーイル、2ーオキソー4ーヒドロキシーピリ ミジンー1ーイル(すなわち、ウラシニル)、2ーオキ ソー4ーヒドロキシー5ーメチルピリミジンー1ーイル (すなわち、チミニル)、4-アミノー5-メチルー2 ーオキソーピリミジンー1ーイル(すなわち、5ーメチ ルシトシニル) 基又はアミノ基が保護された4ーアミノ -5-メチル-2-オキソーピリミジン-1-イル基で ある化合物及びその塩、

0 (7) Bが、6ーベンゾイルアミノブリンー9ーイル、アデニニル、2ーイソブチリルアミノー6ーヒドロキシブリンー9ーイル、グアニニル、2ーオキソー4ーベンゾイルアミノーピリミジンー1ーイル、シトシニル、2ーオキソー5ーメチルー4ーベンゾイルアミノーピリミジンー1ーイル、5ーメチルシトシニル、ウラシニル又はチミニル基である化合物及びその塩をあげることができる。

【0028】又、上記(1)乃至(2)、(3)乃至(4)又は(6)乃至(7)は、番号が大きくなるに従って、より好適な化合物を示し、一般式(1)において、 R^1 を(1)乃至(2)から任意に選択し、 R^2 を(3)乃至(4)から任意に選択し、Aを(5)から任意に選択し、Bを(6)乃至(7)から任意に選択し、又、これらを任意に組み合わせて得られた化合物およびその塩も好適であり、特に好適には、下記群から選択される化合物及びその塩である。

(化合物群) 2'-O, 4'-C-エチレングアノシン、2'-O, 4'-C-エチレンアデノシン、3', 5'-ジ-O-ベンジル-2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン、3', 5'-ジ-O-ベンジル-2'-O, 4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン、2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン、2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン、3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロビル)ホスホロマミダイト

ブチルジメチルシリル基を示し、TBDPSは、tert- *【0034】 ブチルジフェニルシリル基を示し、TIPSは、トリイ 【表1】 ソプロピルシリル基を示す。

【0033】 【化5】

$$R^3$$
 N
 R^4
 R^{10}
 OR^{20}
 R^3
 R^4

————					
化合物	•				
番 号	· A	R1	R ²	R ³	R ⁴
1-1	CH2	Н	Н	Н	. н
1-2	CH2	H	H	Н	NH2
1-3	CH2	H	H	Н	OH
1-4	CH2	H	Н	ОН	H
1-5	CH2	Н	Н	ОН	NH2
1-6	CH2	H	Н	ОН	ОН
1-7	CH2	H	Н	NH ₂	Н
1-8	CH2	H	. Н	NH2	NH2
1-9	CH2	H	Н	NH2	Cl
1-10	CH2	H	Н	NH2	F
1-11	CH₂	H	Н	NH ₂	Br
1-12	CH2	Н	Н	NH ₂	OH
1-13	CH2	H	Н	OMe	Н
1-14	CH2	H	Н	OMe	OMe
1-15	CH2	Н	Н	OMe	NH2
1-16	CH2	Н	Н	Cl	Н
1-17	CH2	H	Н	Br	Н
1-18	CH2	Н .	H	F	Н
1-19	CH2	Н	Н	Cl	Cl
1-20	CH2	Н	·H	SH	Н
1-21	CH2	Bn	Н	NHBz	H
1-22	CH2	Bn	Н	OH	NHCOCH (CH ₃) $_2$
1-23	CH2 .	Bn	Bn	NHBz	H
1-24	CH2	Bn	Bn	OH	NHCOCH (CH ₃) $_2$
1-25	CH2	PMB .	Н	·NHBz	H
1-26	CH2	PMB	H	ОН	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-27	CH2	PMB	PMB	NHBz	Н
1-28	CH2	PMB	PMB	OH	NHCOCH (CH $_3$) $_2$
1-29	CH2	Tr	H	NHBz	Н
1-30	CH2	MMTr	Н	NHBz	Н

23						24
1-31	CH2	DMTr	Н		NHBz	Н
1-32	CH ₂	TMTr	Н		NHBz	Н
1-33	CH ₂	Ťr	Н		ОН	NHCOCH (CH ₃) 2
1-34	CH ₂	MMTr	Н		ОН	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-35	CH2	DMTr	Н .		ОН	NHCOCH (CH ₃) 2
1-36	CH ₂	TMTr	Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-37	CH ₂	TMS	Н		NHBz	Н
1-38	CH ₂	TBDMS	н		NHBz	 Н
1-39	CH ₂	TBDPS	н		NHBz	 Н
1-40	CH ₂	TIPS	н		NHBz	 Н
1-41	CH ₂	TMS	 Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-42	CH ₂	TBDMS	. Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-43	CH ₂	TBDPS	Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-44	CH ₂	TIPS	Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-45	(CH ₂) ₂	Н	H		H	H
1-46	(CH ₂) ₂	H	Н		Н	NH ₂
1-47	(CH ₂) ₂	H	Н		H	OH
1-48	(CH ₂) ₂	H	H		OH	H
1-49	(CH ₂) ₂	H	H		OH	NH ₂
1-50	(CH ₂) ₂	Н .	H		OH	OH
		н Н	n H		NH ₂	
1-51	(CH ₂) ₂	п Н	n H		NH ₂	H NH2
1-52	(CH ₂) ₂				NH2	Cl
1-53	(CH ₂) ₂	Н	H			
1-54	(CH ₂) ₂	Н	H		NH2	F P-
1-55	(CH ₂) ₂	Н	H		NH ₂	Br
1-56	(CH ₂) ₂	Н	H		NH ₂	OH
1-57	(CH ₂) ₂	Н	H	-	OMe	H
1-58	(CH ₂) ₂	Н	H		OMe	OMe
1-59	(CH ₂) ₂	Н	H		OMe	NH ₂
1-60	(CH ₂) ₂	Н	Н		Cl	H
1-61	(CH ₂) ₂	Н	H		Br	H
1-62	(CH ₂) ₂	Н	Н		F	H
1-63	(CH ₂) 2	Н	Н		CI	Cl
1-64	(CH ₂) ₂	H	H	•	SH	H
1-65	(CH ₂) ₂	. Bn	H		NHBz	H "
1-66	(CH ₂) ₂	Bn	H		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-67	(CH ₂) ₂	Bn	Bn		NHBz	H
1-68	(CH ₂) ₂	Bn	Bn		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-69	(CH ₂) ₂	PMB	H		NHBz	H
1-70	(CH ₂) ₂	PMB	H		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-71	(CH ₂) ₂	PMB	PMB		NHBz	H
1-72	(CH ₂) ₂	PMB	PMB		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-73	(CH ₂) ₂	Tr	H		NHBz	H
1-74	(CH ₂) ₂	MMTr	H		NHBz	H
1-75	(CH ₂) ₂	DMTr	H		NHBz	H
1-76	(CH ₂) ₂	TMTr	H		NHBz	H NINGS (OV.)
1-77	(CH ₂) ₂	Tr	H ·		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-78	(CH ₂) ₂	MMTr	Н.		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-79	(CH ₂) ₂	DMTr	Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂
1-80	$(CH_2)_2$	TMTr	Н		OH	NHCOCH (CH ₃) ₂

25			(10)	26
1-81	(CH ₂) ₂	TMS	Н	NHBz H
1-82	(CH ₂) ₂	TBDMS	 H	NHBz H
1-83	(CH ₂) ₂	TBDPS	 H	NHBz H
1-84	(CH ₂) ₂	TIPS	H	NHBz H
1-85	(CH ₂) ₂	TMS	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-86	(CH ₂) ₂	TBDMS	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-87	(CH ₂) ₂	TBDPS	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
	(CH ₂) ₂	TIPS	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-88		. H	n H	'H H
1-89	(CH ₂) ₃	, п Н		
1-90	(CH ₂) ₃		H .	
1-91	(CH ₂) ₃	Н	H	
1-92	(CH ₂) ₃	Н	H	OH H
1-93	(CH ₂) ₃	Н	H	OH NH ₂
1-94	(CH ₂) ₃	H	Н	OH OH
1-95	(CH ₂) ₃	Н	H	NH ₂ H
1-96	(CH ₂) ₃	Н	Н	NH ₂ NH ₂
1-97	(CH ₂) ₃	Н	H	NH ₂ CI
1-98	(CH ₂) ₃	Н	H	NH ₂ F
1-99	(CH ₂) ₃	Н	H	NH ₂ · Br
1-100	(CH ₂) ₃	H	H	NH ₂ OH
1-101	(CH ₂) ₃	H	H	OMe H
1-102	(CH ₂) ₃	Н	H	OMe OMe
1-103	(CH ₂) ₃	Н	H	OMe NH ₂
1-104	(CH ₂) ₃	Н	H	CI H
1-105	(CH ₂) ₃	Н	H	Br H
1-106	(ĆH ₂)з	Н	H	F H
1-107	(CH ₂) ₃	• Н	H	CI CI
1-108	(CH ₂) ₃	Н	H 	SH H
1-109	(CH ₂) ₃	Bn	H	NHBz H
1-110	(CH ₂) ₃	Bn	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-111	(CH ₂) ₃		Bn	NHBz H
1-112	(CH ₂) ₃	Bn	Bn	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-113	(CH ₂) ₃	PMB	H 	NHBz H
1-114	(CH ₂) ₃	PMB	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-115	(CH ₂) ₃	PMB	PMB	NHBz H
1-116	(CH ₂) ₃		PMB	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-117	(CH ₂) ₃	Tr	H	NHBz H
1-118	(CH ₂) ₃	MMTr	H	NHBz H
1-119	(CH ₂) ₃	DMTr	H	NHBz H
1-120	(CH ₂) ₃	TMTr	Н	NHBz H
1-121	(CH ₂) ₃	Tr	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-122	(CH ₂) ₃	MMTr	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-123	(CH ₂) ₃	DMTr	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-124	(CH ₂) ₃	TMTr	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-125	(CH ₂) ₃	TMS	H	NHBz H
1-126	(CH ₂) ₃	TBDMS	Н	NHBz H
1-127	(CH ₂) ₃	TBDPS	H	NHBz H
1-128	(CH ₂) ₃	TIPS	H	NHB2 H
1-129	(CH ₂) ₃	TMS	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-130	(CH ₂) ₃	TBDMS	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂

27				28
1-131	(CH ₂) ₃	TBDPS	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-132	(CH ₂) ₃	TIPS	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-133	(CH ₂) ₄	• H	Н	н н
1-134	(CH ₂) ₄	Н	Н	H NH2
1-135	(CH ₂) ₄	H	Н	н он
1-136	(CH ₂) ₄	Н	Н	ОН Н
1-137	(CH ₂) 4	Н	Н	OH NH2
1-138	(CH ₂) ₄	Н	Н	OH OH
1-139	(CH ₂) 4	H	Н	NH ₂ H
1-140	(CH ₂) 4	H	H	NH2 NH2
1-141	(CH ₂) 4	H	Н	NH ₂ Cl
1-142	(CH ₂) 4	H	H	NH ₂ F
1-143	(CH ₂) 4	н	Н	NH ₂ Br
1-144	(CH ₂) 4	 H	H	NH ₂ OH
1-145	(CH ₂) 4	H	 H	OMe H
1-146	(CH ₂) 4	н	H	OMe OMe
1-147	(CH ₂) 4	н	H ·	OMe NH ₂
1-148	(CH ₂) 4	н .	H .	CI H
1-149	(CH ₂) 4	н	Н	Br _. H
1-150	(CH ₂) 4	 Н	 H	F H
1-151	(CH ₂) 4	н	H	cı cı
1-152	(CH ₂) 4	н	H	SH H
1-153	(CH ₂) 4	Bn ·	H	NHBz H
1-154	(CH ₂) ₄	Bn	Н .	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-155	(CH ₂) 4	Bn	Bn	NHBz H
1-156	(CH ₂) ₄	Bn	Bn	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-157	(CH ₂) 4	PMB	H	NHBz H
1-158	(CH ₂) ₄	PMB	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-159	(CH ₂) ₄	PMB	PMB	NHBz H
1-160	(CH ₂) 4	PMB	PMB	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-161	(CH ₂) ₄	Tr	Н	NHBz H
1-162	(CH ₂) 4	MMTr	H	NHBz H
1-163	(CH ₂) 4	DMTr	Н	NHBz H
1-164	(CH ₂) ₄	TMTr	Н	NHBz H
1-165	(CH ₂) 4	Tr	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-166	(CH ₂) 4	MMTr	н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-167	(CH ₂) 4	DMTr	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-168	(CH ₂) ₄	TMTr	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-169	(CH ₂) ₄	TMS	Н	NHBz H
1-109	(CH ₂) ₄	TBDMS	H	NHBz H
1-171	(CH ₂) ₄	TBDPS	H	NHBz H
1-172	(CH ₂) ₄	TIPS	H	NHBz H
	(CH ₂) ₄	TMS	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
- 1-173 1-174	(CH ₂) ₄	TBDMS	H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-174	(CH ₂) ₄	TBDPS	n H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
	(CH ₂) ₄	TIPS	п Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-176	CH ₂	11F3 H	п Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-177 1-178	CH ₂	п Н	н Н	NHBz H
	CH ₂) ₂	n H	л Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-179 1-180	(CH ₂) ₂	п Н	п Н	NHB2 H
1-100	(UII2) 2	п	11	ипод п

.

29				30
1-181	(CH ₂) ₃	Н .	H .	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-182	(CH ₂) ₃	H	Н	NHBz H
1-183	(CH ₂) ₄	H	Н	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-184	(CH ₂) ₄	Н	Н	NHBz H
1-185	CH2	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-186	CH ₂	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	NHBz H
1-187	(CH ₂) ₂	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	OH NHCOCH (CH3) 2
1-188	$(CH_2)_2$	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	NHBz H
1-189	(CH ₂) ₃	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-190	(CH ₂) ₃	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	NHBz H
1-191	(CH ₂) 4	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	OH NHCOCH (CH3) 2
1-192	(CH ₂) ₄	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)$	NHBz H
1-193	CH2	DMTr	P(N(iPr) ₂)(OCH ₃)	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-194	CH ₂	DMTr	P(N(iPr) ₂)(OCH ₃)	NHBz H
1-195	(CH ₂) ₂	DMTr	$P(N(iPr)_2)$ (OCH ₃)	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-196	(CH ₂) ₂	DMTr	$P(N(iPr)_2)$ (OCH ₃)	NHBz H
1-197	$(CH_2)_3$	DMTr	$P(N(iPr)_2)$ (OCH ₃)	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-198	(CH ₂) ₃	DMTr	P(N(iPr) ₂)(OCH ₃)	NHB2 H
1-199	(CH ₂) ₄	DMTr	$P(N(iPr)_2)(OCH_3)$	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-200	(CH ₂) ₄	DMTr	$P(N(iPr)_2)$ (OCH ₃)	NHBz H
1-201	CH ₂	DMTr	P(0) (0H)H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-202	CH ₂	DMTr	P(0)(0H)H	NHBz H
1-203	(CH ₂) ₂	DMTr	P(0)(0H)H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-204	(CH ₂) ₂	DMTr	P(0)(0H)H	NHBz H
1-205	(CH ₂) ₃	DMTr	P(0)(0H)H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-206	(CH ₂) ₃	DMTr	P(0) (0H) H	NHBz H
1-207	(CH ₂) ₄	DMTr ·	P(0)(OH)H	OH NHCOCH (CH ₃) ₂
1-208	(CH ₂) 4	DMTr	P(0) (0H) H	NHBz H

【0035】 【化6】 30*【0036】 【表2】

(1")

4(

例 示 化合物		* 8 8			
番 号	A	R ¹	R²	R ⁵ R ⁶	_
2-1	CH ₂	Н	Н	ОН Н	
2-2	CH2	Н	Н	ОН СН3	
2-3	CH2	Н	Н	NH ₂ H	
2-4	CH2	Н	Н	NH ₂ CH ₃	

			(10)		
31	011	.,	••		32
2-5	CH2	H	Н	NH ₂	F
2-6	CH2	Н	H	Cl	Н
2-7	CH2	Н	Н	OMe	Н
2-8	CH2	Н	Н	SH	Н
2-9	CH2	Bn	H	OH	Н
2-10	CH2	Bn	Bn	OH	H
2-11	CH2	PMB	Н	OH	Н
2-12	CH_2	PMB	PMB	OH	H
2-13	CH_2	Tr	Н	OH	H
2-14	$\mathtt{CH}_{\mathbf{z}}$	MMTr	Н	OH	H
2-15	CH2	DMTr	Н	OH	H
2-16	CH2	TMTr	Н	OH	H
2-17	CH2	TMS	Н	OH	H
2-18	CH2	TBDMS	H	OH	Н
2-19	. CH2	TBDPS	Н	OH -	H
2-20	CH2	TIPS	Н	OH	H
2-21	CH2	Bn	Н	OH	CH3
2-22	CH_2	Bn	Bn	ОН	СНэ
2-23	CH_2	PMB	Н	ОН	СНэ
2-24	CH2	PMB	PMB	OH	СНз
2-25	CH2	Tr	Н	ОН	СНэ
2-26	CH2	MMTr	Н	OH	СНз
2-27	CH2	DMTr	Н	OH	СНз
2-28	CH2	TMTr	Н	ОН	СНз
2-29	CH2	TMS	Н	ОН	СНз
2-30	CH2	TBDMS	Н	ОН	СНз
2-31	CH2	TBDPS	Н	OH	СНз
2-32	CH2	TIPS	Н	OH	СНз
2-33	CH2	Bn	Н	NHBz	Н
2-34	CH2	Bn	Bn	NHBz	Н
2-35	CH2	PMB	Н	NHBz	Н
2-36	CH2	PMB	PMB	NHBz	Н
2-37	CH2	Tr	Н	NHBz	Н
2-38	CH2	MMTr	Н	. NHBz	Н
2-39	CH2	DMTr	Н	NHBz	H
2-40	CH2	TMTr	Н	NHBz	Н
2-41	CH2	TMS	H .	NHBz	Н
2-42	CH2	TBDMS	Н	NHBz	H
2-43	CH2	TBDPS	Н	NHBz	Н
2-44	CH2	TIPS	Н	NHBz	Н
2-45	CH ₂	Bn	Н	NHBz	СНз
2-46	CH2	Bn	Bn	NHBz	СНз
2-47	CH2	PMB	Н	NHBz	СНз
2-48	CHz	PMB	PMB	NHBz	СНз
2-49	CH ₂	Tr	Н	NHBz	СНз
2-50	CH ₂	MMTr	Н	NHBz	СНз
2-51	CH ₂	DMTr	H	NHB2	СНз
2-52	CH ₂	TMTr	Н	NHB2	СНз
2-53	CH ₂	TMS	H	NHBz	СНз
2-54	CH ₂	TBDMS	H	NHBz ·	СНз
- 01	3112	טוויטטו	••	111102	V.13

33					34
2-55	CH2	TBDPS	H	NHBz	СНз
2-56	CH2	TIPS	H	NHBz	СНз
2-57	(CH ₂) ₂	Н	Н	OH	H
2-58	(CH ₂) ₂	Н	Н	ОН	СНз
2-59	$(CH_2)_2$	H	Н	NH2	H
2-60	$(CH_2)_2$	Н	Н	NH_2	СНэ
2-61	$(CH_2)_2$	Н	Н	NH ₂	F
2-62	(CH ₂) ₂	H	Н	Cl	Н
2-63	(CH ₂) ₂	Н	Н	OMe	Н
2-64	(CH ₂) ₂	Н	Н.	SH	Н
2-65	(CH ₂) ₂	Bn	Н	ОН	Н
2-66	(CH ₂) ₂	Bn	Bn	ОН	Н
2-67	(CH ₂) ₂	PMB	Н	OH	H
2-68	(CH ₂) ₂	PMB	PMB	OH	Н
2-69	(CH ₂) ₂	Tr	Н	ОН	Н
2-70 -	(CH ₂) ₂	MMTr	Н	OH	Н
2-71	(CH ₂) ₂	DMTr	H	ОН	Н
2-72	(CH ₂) ₂	TMTr	н .	OH	H
2-73	(CH ₂) ₂	TMS	 Н	OH	H
2-74	(CH ₂) ₂	TBDMS	 H	ОН	H
2-75	(CH ₂) ₂	TBDPS	 H	OH	Н
2-76	(CH ₂) ₂	TIPS	н	OH	H
2-77	(CH ₂) ₂	Bn	 Н	OH	и СНз
2-78	(CH ₂) ₂	Bn	Bn	ОН	СНз
2-79	(CH ₂) ₂	PMB	Н	OH	СНз
2-80	(CH ₂) ₂	PMB	PMB	OH	СНз
2-81	(CH ₂) ₂	Tr	Н	OH	CH ₃
2-82	(CH ₂) ₂	MMTr	H	OH	СНз
2-83	(CH ₂) ₂	DMTr	н	OH	СНз
2-84	(CH ₂) ₂	TMTr	H	OH	СНз
2-85	(CH ₂) ₂	TMS	H	OH	CHa
2-86	(CH ₂) ₂	TBDMS	H	OH	СНз
2-87	(CH ₂) ₂	TBDPS	. Н	OH	СНз
2-88	(CH ₂) ₂	TIPS	Н	OH	СНз
2-89	(CH ₂) ₂	Bn	Н	NHBz	Н
2-90	(CH ₂) ₂	Bn	Bn .	NHBz	H
2-91	(CH ₂) ₂	PMB	Н	NHBz	H
2-92	(CH ₂) ₂	PMB	PMB	NHBz	 H
2-93	(CH ₂) ₂	Tr	Н	NHBz	 H
2-94	(CH ₂) ₂	MMTr	H	NHBz	H
2-95	(CH ₂) ₂	DMTr	H	NHBz	H
2-96	(CH ₂) ₂	TMTr	H	NHBz	H
2-97	(CH ₂) ₂	TMS	Н	NHBz	H
	(CH ₂) ₂	TBDMS	Н	NHBz	Н
2-98		TBDPS	п Н	NHBz	H
2-99	(CH ₂) ₂	TIPS	n H	NHBz	н .
2-100	(CH ₂) ₂		н Н		п СНз
2-101	(CH ₂) ₂	Bn Pn		NHBz NHB2	спз СНз
2-102	(CH ₂) ₂	Bn DMD	Bn u	NHB2	спз СНз
2-103	(CH ₂) ₂	PMB	H	NHBz	
2-104	$(CH_2)_2$	PMB	PMB	NHBz	СНз

			(10)		
35					36
2-105	$(CH_2)_2$	Tr	Н	NHBz	СНз
2-106	$(CH_2)_2$	MMTr	Н	NHBz	СНз
2-107	$(CH_2)_2$	DMTr	Н	NHBz	СНз
2-108	$(CH_2)_2$	TMTr	Н	NHBz	СНз
2-109	$(CH_2)_2$	TMS	Н	NHBz	СНз
2-110	$(CH_2)_2$	TBDMS	H	NHBz	СНз
2-111	$(CH_2)_2$	TBDPS	H	NHBz	СНз
2-112	$(CH_2)_2$	TIPS	H	NHBz	СНз
2-113	$_{\rm E}$ (CH ₂)	Н	Н	OH	Н
2-114	$(CH_2)_3$	H	Н	OH	СНз
2-115	$(CH_2)_3$	H	. Н	NH2	H
2-116	(CH ₂) ₃	H	Н	NH_2	СНз
2-117	(CH ₂) 3	H	Н	NH2	F
2-118	(CH ₂) ₃	H	Н	Cl	H
2-119	$(CH_2)_3$	H	Н	OMe	Н
2-120	(CH ₂) ₃	Н	Н	SH	Н
2-121	(СН ₂) з	Bn	Н	OH	Н
2-122	$(CH_2)_3$	Bn	Bn	OH	Н
2-123	(CH ₂) ₃	PMB	Н	ОН	H
2-124	(CH ₂) ₃	PMB .	PMB	OH	H
2-125	(CH ₂) ₃	Tr	Н	ОН	H
2-126	(CH ₂) ₃	MMTr	H	ОН	Н
2-127	(CH ₂) ₃	DMTr	H	ОН	Н
2-128	(CH ₂) ₃	TMTr	Н.	OH	H
2-129	(CH ₂) ₃	TMS	H	ОН	H
2-130	(CH ₂) ₃	TBDMS	Н	OH	H
2-131	(CH ₂) ₃	TBDPS	H	ОН	H
2-132	(CH ₂) ₃	TIPS	H	OH	H
2-133	(CH ₂) ₃	Bn	H	OH	СНз
2-134	(CH ₂) ₃	Bn	Bn	OH	СНз
2-135	(CH ₂) ₃	PMB	H	OH	СНз
2-136	(CH ₂) ₃	PMB	PMB	OH	СНз
2-137	(CH ₂) ₃	Tr	Н	OH	CH ₃
2-138	(CH ₂) ₃	MMTr	Н	OH	СНз
2-139	(CH ₂) ₃	DMTr	Н .	OH	СНз
2-140	(CH ₂) ₃	TMTr	Н	OH	СНз
2-141	(CH ₂) ₃	TMS	H	OH OH	СН3 Си
2-142	(СН ₂) э (СН ₂) з	TBDMS TBDPS	. Н	OH	CH ₃
2-143	(CH ₂) ₃	TIPS	Н	OH OH	CH3
2-144	(CH ₂) 3	Bn	H	NHBz	Н
2-145	(CH ₂) ₃	Bn	Bn	NHBz	H
2-146 2-147	(CH ₂) 3	PMB	Н	NHBz	H
2-147	(CH ₂) ₃	PMB	PMB.	NHBz	H
2-149	(CH ₂) ₃	Tr	Н	NHBz	H
2-149	(CH ₂) ₃	MMTr	Н	NHBz	H
2-150	(CH ₂) ₃	DMTr	H	NHBz	H
2-151	(CH ₂) ₃	TMTr	Н	NHBz	H
2-152	(CH ₂) ₃	TMS	Н	NHBz	H
2-154	(CH ₂) ₃	TBDMS	H	NHBz	H
7 104	(0112/3	ישומם		MIDL	

			(10)		
37					38
2-155	$(CH_2)_3$	TBDPS	Н	NHBz	H
2-156	(CH ₂) ₃	TIPS	Н	NHBz	H.
2-157	$(CH_2)_3$	Bn	H	NHBz	СНз
2-158	(CH ₂) ₃	Bn	Bn	NHBz	СНз
2-159	(CH ₂) ₃	PMB	H	NHBz	СНз
2-160	$(CH_2)_3$	PMB	PMB	NHBz	СНэ
2-161	$(CH_2)_3$	Tr	Н	NHBz	СНз
2-162	$(CH_2)_3$	MMTr	Н	NHBz	СНз
2-163	$(CH_2)_3$	DMTr	H	NHBz	СНз
2-164	$(CH_2)_3$	TMTr	Н	NHBz	СНз
2-165	(CH ₂) ₃	TMS	H	NHBz	СНз
2-166	$(CH_2)_3$	TBDMS	H	NHBz	СНз
2-167	$(CH_2)_3$	TBDPS	H	NHBz	СНз
2-168	$(CH_2)_3$	TIPS	H	NHBz	СНэ
2-169	$(CH_2)_4$	H	H	OH	Н
2-170	$(CH_2)_4$	Н	H	OH	СНз
2-171	$(CH_2)_4$	H	Н	NH2	H
2-172	$(CH_2)_4$	Н	H	NH_{2}	СНз
2-173	$(CH_2)_4$	H	H	NH_2	F
2-174	$(CH_2)_4$	H	H	Cl	H
2-175	$(CH_2)_4$	H	H	OMe	Н
2-176	(CH ₂) ₄	H	H	SH .	H
2-177	(CH ₂) ₄	Bn	H	OH	H
2-178	$(CH_2)_4$	- Bn	Bn	OH	Н
2-179	$(CH_2)_4$	PMB	Н	OH	Н .
2-180	(CH ₂) ₄	PMB	PMB	OH	Н
2-181	$(CH_2)_4$	Tr	Н	ОН	Н
2-182	(CH ₂) ₄	MMTr	H	ОН	H
2-183	(CH ₂) ₄	DMTr	Н	ОН	Н
2-184	(CH ₂) ₄	TMTr	Н	OH	H
2-185	$(CH_2)_4$	TMS	H	ОН	Н
2-186	$(CH_2)_4$	TBDMS	Н	ОН	Н
2-187	(CH ₂) ₄	TBDPS	. Н	OH	H
2-188	(CH ₂) ₄	TIPS	Н .	ОН	Н
2-189	(CH ₂) ₄	Bn	Н	ОН	СНз
2-190	(CH ₂) ₄	Bn	Bn	OH	СНз
2-191	(CH ₂) ₄	PMB	.Н	OH	СНз
2-192	(CH ₂) ₄	PMB	PMB	ОН	СНз
2-193	(CH ₂) ₄	Tr	Н	ОН	СНз
2-194	(CH ₂) ₄	MMTr	Н	ОН	СНз
2-195	(CH ₂) ₄	DMTr	Н	ОН	СНз
2-196	(CH ₂) ₄	TMTr	Н	ОН	СНз
2-197	(CH ₂) ₄	TMS	Н	OH	СНз
2-198	(CH ₂) ₄	TBDMS	Н	OH	СНз
2-199	(CH ₂) ₄	TBDPS	H	OH	СНз
2-200	(CH ₂) 4	TIPS	H	OH	СНз
2-201	(CH ₂) ₄	Bn	Н	NHBz	H
2-202	(CH ₂) ₄	Bn	Bn 	NHBz	H
2-203	(CH ₂) ₄	PMB	H	NHBz	H
2-204	(CH ₂) ₄	PMB	PMB	NHBz	Н

```
40
     39
2-205
                                 Tr
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                        Н
             (CH<sub>2</sub>) 4
                                                                                        Н
2-206
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              MMTr
                                                  Н
                                                                            NHBz
2-207
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              DMTr
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                        H
2-208
             (CH<sub>2</sub>) 4
                              TMTr
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                        H
2-209
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                               TMS
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
2-210
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                            TBDMS
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
                                                  Н
                                                                                         H
2-211
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                            TBDPS
                                                                            NHBz
2-212
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              TIPS
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
2-213
                                                  Н
                                                                            NHBz
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                                 Bn
                                                                                         СНз
2-214
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                                 Bn
                                                  Bn
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-215
                                PMB
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                                                                                         СНз
                                PMB
                                                  PMB
                                                                            NHBz
2-216
             (CH_2)_4
2-217
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                                 Tr
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-218
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              MMTr
                                                  H
2-219
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              DMTr
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-220
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              TMTr
                               TMS
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-221
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
2-222
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                            TBDMS
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-223
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                             TBDPS
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
                                                                                         СНз
2-224
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                              TIPS
                                                  H
                                                                            NHBz
2-225
                               Н
                                                  H
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
            CH2
                               Н
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-226
            CH_2
2-227
                                H
                                                   Н
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
             (CH_2)_2
2-228
                                H
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
             (CH_2)_2
                                                  Н
2-229
             (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                Н
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
2-230
             (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                H
                                                .. H
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
                                H
                                                  Н
                                                                            NHBz
                                                                                         H
2-231
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
2-232
             (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                                H
                                                   Н
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-233
            CH_2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                                          Н
            CH_2
                                                                               OH
                                                                                           СНз
2-234
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                              NHBz
                                                                                          H
2-235
            CH2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                              NHBz
                                                                                           СНз
2-236
            CH2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
2-237
           (CH_2)_2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                                           Н
           (CH_2)_2
2-238
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                                           СНз
                                                                              NHBz
                                                                                           Н
2-239
           (CH_2)_2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                              NHBz
                                                                                           СНз
2-240
           (CH_2)_2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                                           Н
2-241
           (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                               OH
                                                                                           СНз
2-242
           (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
2-243
           (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                              NHBz
                                                                                          H
                                                                              NHBz
                                                                                           СНз
2-244
           (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                                           Н
2-245
           (CH_2)_4
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
2-246
           (CH_2)_4
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                               OH
                                                                                           СНз
                                                                              NHBz
                                                                                          Н
2-247
           (CH<sub>2</sub>) ₄
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
2-248
           (CH_2)_4
                                                                              NHBz
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OC_2H_4CN)
                                                                                           СНз
                                                                                         Н
                                                                            OH
2-249
            CH2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                            P(N(iPr)<sub>2</sub>) (OCH<sub>3</sub>)
                                                                            OH
                                                                                         СНз
2-250
            CH2
                                DMTr
                                DMTr
                                            P(N(iPr)<sub>2</sub>) (OCH<sub>3</sub>)
                                                                            NHBz
                                                                                         Н
2-251
             CH2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2) (OCH<sub>3</sub>)
                                                                            NHBz
                                                                                         СНз
2-252
            CH2
2-253
           (CH_2)_2
                                DMTr
                                            P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                              OH
                                                                                          Н
                                                                                           СНз
2-254
           (CH_2)_2
                                DMTr
                                             P(N(iPr)<sub>2</sub>)(OCH<sub>3</sub>)
                                                                              OH
```

```
41
                                                                                 42
                                                                              Н
2-255
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   NHBz
        (CH_2)_2
         (CH_2)_2
                           DMTr
                                                                   NHBz
                                                                              СНз
2-256
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
2-257
         (CH_2)_3
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   OH
                                                                              Н
         (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>
                           DMTr
                                                                   OH
                                                                              СНз
2-258
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
2-259
         (CH_2)_3
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   NHBz
                                                                              Н
                                                                 · NHBz
                                                                              СНз
2-260
          (CH_2)_3
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                              H
2-261
          (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   OH
                                                                   OH
                                                                              СНз
          (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
                           DMTr
                                      P(N(iPr)<sub>2</sub>) (OCH<sub>3</sub>)
2-262
2-263
          (CH_2)_4
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   NHBz
                                                                              Н
2-264
         (CH_2)_4
                           DMTr
                                      P(N(iPr)_2)(OCH_3)
                                                                   NHBz
                                                                              СНз
```

上記表1乃至2中、好適な化合物は、(1-5)、(1 -7), (1-23), (1-24), (1-31), (1-35), (1-39), (1-43), (1-49), (1-51), (1-67), (1-68), (1-75), (1-79), (1-83), (1-87), (1-93), (1-95), (1-111), (1-112), (1-119), (1-123), (1-127), (1-131), (1-137), (1-139), (1-155), (1-156), (1-163), (1-167), (1-171), (1-175), (1-177), (1-178), (1-185), (1-186), (1-193), (1-194), (1-201), (1-202), (2-1), (2-2), (2-3), (2-4), (2-10), (2-15), (2-19), (2-2)(2-27), (2-31), (2-34), (2-39), (2-43), (2-46), (2-5)1), (2-55), (2-57), (2-58), (2-59), (2-60), (2-66), (2-7)1), (2-75), (2-78), (2-83), (2-87), (2-90), (2-95), (2-99), (2-102), (2-107), (2-111), (2-113), (2-114), (2-115), (2-116), (2-122), (2-127), (2-131), (2-134), (2-139) (2-143) (2-146) (2-15)1), (2-155), (2-158), (2-16)3), (2-167), (2-169), (2-17)(2-171), (2-172), (2-17)8), (2-183), (2-187), (2-19)0), (2-195), (2-199), (2-20)2), (2-207), (2-211), (2-214), (2-219), (2-223), (2-22 5), (2-226), (2-233), (2-234)、(2-235)又は(2-236)であり、さら に好適には、2'-O,4'-C-エチレングアノシン(1 -5)、2'-O,4'-C-エチレンアデノシン(1-7)、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレン-6-Nーベンゾイルアデノシン(1-23)、

3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン(1-24)、5°-O -ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-6-N ーベンゾイルアデノシン (1-31)、5°-O-ジメ トキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イ ソプチリルグアノシン(1-35)、2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシン(1-17 7)、2'-O,4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルア 20 デノシン (1-178)、5-O-ジメトキシトリチル-2'-O, 4'-C-エチレン-2-N-イソブチリルグアノシ ン-3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロ ピル) ホスホロアミダイト (1-185)、5-0-ジメ トキシトリチル - 2'-O, 4'-C-エチレン-6-N-ベン $ilde{V}$ イルアデノシン -3'-O-(2-シアノエチル N,N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト (1-18 6)、2'-O,4'-C-エチレンウリジン(2-1)、 2'-O,4'-C-エチレン5-メチルウリジン(2-2)、2'-O,4'-C-エチレンシチジン(2-3)、 2'-O.4'-C-エチレン-5-メチルシチジン(2-4)、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレンウリジン(2-10)、5'-Q-ジメトキシトリ チル-2'-O,4'-C-エチレンウリジン(2-1 5)、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレン-5-メチルウリジン(2-22)、5'-O-ジメ トキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-5-メチル ウリジン (2-27)、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン (2-34)、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.40 4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン(2-3 9)、3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エ チレン-4-N-ベンゾイル-5-メチルシチジン(2-4 6)、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル-5-メチルシチジン(2-51)、2'-O,4'-C-エチレン-4-Nーベンゾイル シチジン (2-225)、2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル-5-メチルシチジン(2-22 6)、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチ レン-ウリジン-3'-O-(2-シアノエチル N, N-50 ジイソプロピル)ホスホロアミダイト(2-233)、

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-5 -メチルウリジン-3'-O-(2-シアノエチル N, N ージイソプロピル)ホスホロアミダイト(2-23 4)、5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチ レン-4-N-ベンゾイルシチジン-3'-O- (2-シアノ エチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト (2-235)、又は、5'-O-ジメトキシトリチルー2'-O. 4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルー5-メチ ルシチジン-3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジ る。

[0037]

【発明の実施の形態】本発明の化合物(1)は、以下に 述べるA法により、製造することができる。

【0038】A法中、Xは、保護基を示し、Yは、保護 基を示し、Aは、前述と同意義を示し、B1は、プリン - 9 - イル基、前述のα群から選択される置換基を有す る置換プリンー9ーイル基又は2ーオキソーピリミジン -1-イル基を示すが、「保護されていてもよいアミノ 基」のうち、無保護のアミノ基は除かれ、B²は、プリ ンー 9 ーイル基、前述のα群から選択される置換基を有 する置換プリンー 9 ーイル基又は 2 ーオキソーピリミジ ンー1-イル基を示すが、「保護されていてもよいアミ ノ基」のうち、保護されたアミノ基は除かれ、R⁷は、 脱離基を形成する基である。R⁸は、炭素数1乃至4個 の脂肪族アシル基である。

【0039】Xの保護基は、前述のR¹における「水酸 基の保護基」と同一のものである。

【0040】Yの保護基は、前述のR²における「水酸 基の保護基」と同一のものである。

【0041】R⁷の「脱離基を形成する基」としては、 例えば、メタンスルホニル、エタンスルホニルのような 低級アルキルスルホニル基、トリフルオロメタンスルホ ニルのような、ハロゲン置換低級アルキルスルホニル 基、p-トルエンスルホニルのようなアリールスルホニ ル基をあげることができ、好適には、メタンスルホニル 基又はpートルエンスルホニル基である。

【0042】R*の「炭素数2乃至4個の脂肪族アシル 基」としては、例えば、アセチルプロピオニル、ブチリ ル基等をあげることができ、好適には、アセチル基であ 40 る。

【0043】以下、A法の各工程について、詳しく説明 する。

(A-1工程) 本工程は、不活性溶剤中、塩基触媒の存 在下、後述するB乃至D法により製造することができる 化合物(3)に、脱離基導入試薬を反応して、化合物 (4)を製造する工程である。

【0044】使用される溶剤としては、例えば、ヘキサ ン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪

芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、 四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロ ロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;蟻酸エチ ル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエ チルのようなエステル類:ジエチルエーテル、ジイソプ ロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジ メトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテ ルのようなエーテル類;アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキ イソプロピル) ホスホロアミダイト(2-236)であ 10 サノンのようなケトン類;ニトロエタン、ニトロベンゼ ンのようなニトロ化合物類:アセトニトリル、イソブチ ロニトリルのようなニトリル類;ホルムアミド、N, N ージメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミ ド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチルピロリジ ノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド 類;スルホランのようなスルホキシド類;ピリジン類を あげることができるが、好適には、ピリジンである。 【0045】使用される塩基触媒としては、好適には、

トリエチルアミン、ピリジン、ジメチルアミノピリジン 20 のような塩基である。

【0046】使用される脱離基導入試薬としては、例え ば、メタンスルホニルクロリド、エタンスルホニルブロ ミドのようなアルキルスルホニルハライド類;p-トルエ ンスルホニルクロリドのようなアリールスルホニルハラ イド類をあげることができ、好適には、メタンスルホニ ルクロリド及びp-トルエンスルホニルクロリドである。 【0047】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、脱離基導入試薬、塩基触媒により異なるが、通常、 0℃乃至50℃であり、好適には、10乃至40℃であ 30 る。

【0048】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、脱離基導入試薬、塩基触媒、反応温度により異なる が、通常、10分乃至24時間であり、好適には、1乃 至10時間である。

【0049】反応終了後、本反応の目的化合物(4)は、 例えば、反応液を中和し、反応混合物を濃縮し、水と酢 酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、 目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウ ム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0050】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 によって更に精製できる。

(A-2工程) 本工程は、溶剤中、酸触媒の存在下、A - 1 工程で製造される化合物(4)に、酸無水物を反応 し、化合物(5)を製造する工程である。

【0051】使用される溶剤としては、例えば、ジエチ ルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのような エーテル類:アセトニトリル、イソブチロニトリルのよ うなニトリル類:ホルムアミド、N, N-ジメチルホル 族炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレンのような 50 ムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル

46 福営 りかかこしり

- 2 - ピロリドン、N-メチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類;酢酸のような有機酸等をあげることができるが、好適には、酢酸である。

【0052】使用される酸触媒としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸等の無機酸をあげることができるが、好適には、硫酸(特に、濃硫酸)である。

【0053】使用される酸無水物としては、例えば、無水酢酸、無水プロピオン酸等の低級脂肪族カルボン酸の無水物をあげることができるが、好適には、無水酢酸である。

【0054】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒、酸無水物により異なるが、通常、0℃乃至 50℃であり、好適には、10乃至40℃である。

【0055】反応時間は、使用される原料化合物、溶剤、酸触媒、酸無水物、反応温度により異なるが、通常、10分乃至12時間であり、好適には、30分乃至3時間である。

【0056】反応終了後、本反応の目的化合物(5)は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0057】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(A-3工程) 本工程は、不活性溶剤中、酸触媒の存在下、A-2工程で製造される化合物 (5) に、文献 (H. Vorbrggen, K. Krolikiewicz and B. Bennua, Chem. Ber., 114, 1234-1255 (1981)) に従って調製した、所望の置換基を有していてもよいプリン又はピリミジンに対応するトリメチルシリル化体を反応して、化合物 (6) を製造する工程である。

【0058】使用される溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類;ホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類;硫化炭素等をあげることができるが、好適には、1,2-ジクロエタンである。

【0059】使用される酸触媒としては、例えば、AICl s. SnCl₄, TiCl₄, ZnCl₂, BF₃, トリフルオロメタンスル ホン酸トリメチルシリルのようなルイス酸触媒等をあげ ることができ、好適には、トリフルオロメタンスルホン 酸トリメチルシリルである。

【0060】反応温度は、使用される原料化合物、溶

剤、酸触媒により異なるが、通常、0℃から100℃であり、好適には、50℃乃80℃である。

【0061】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒、反応温度により異なるが、通常、1時間乃 至24時間であり、好適には、1時間乃至8時間であ

【0062】反応終了後、本反応の目的化合物(6)は、 例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような 混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む 有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶 剤を留去することで得られる。

【0063】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(A-4工程)本工程は、不活性溶剤中、塩基触媒の存在下、A-3工程で製造される化合物(6)を環化して、本発明の化合物(1a)を製造する工程である。

【0064】使用される溶剤としては、水;ピリジン類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニト20 リル類;ホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類;あるいはそれらの混合溶剤である。

"【0065】使用される塩基触媒としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド;アンモニア水等をあげることができ、好適には、アルカリ金属水酸化物(特に、水酸化ナトリウム)である。

【0066】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒により異なるが、通常、0℃乃至50℃であ り、好適には、10℃乃至30℃である。

【0067】反応時間は、使用される原料化合物、溶剤、酸触媒、反応温度により異なるが、通常、1分乃至5時間であり、好適には、1分乃至30分である。

【0068】反応終了後、本反応の目的化合物(1a) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0069】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(A-5工程)本工程は、不活性溶剤中、A-4工程で 得られる化合物(la)に、脱保護試薬を反応して、化 合物(lb)を製造する工程である。

50 【0070】脱保護の方法は、保護基の種類によって異

なるが、他の副反応を生じない方法であれば、特に限定はなく、例えば、"Protective Groups in Organic Synthesis" (Theodora W. Greene、Peter G. M. Wuts著、1999年、A Wiley-Interscience Publication発行)に記載の方法によって、行うことができる。

【0071】特に、保護基が、(1)「脂肪族アシル基 又は芳香族アシル基」、(2)「1乃至3個のアリール 基で置換されたメチル基」又は「低級アルキル、低級ア ルコキシ、ハロゲン、シアノ基でアリール環が置換され た1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基」、

(3)「シリル基」の場合には、以下の方法により行うことができる。

(1)脂肪族アシル基及び芳香族アシル基の場合は、通常、不活性溶剤中、塩基を反応して行う。

【0072】使用される溶剤は、水と混合しやすく、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば、特に限定はなく、例えば含水のまたは無水の、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド類:メチレンクロリド、クロロホルム、1,2一ジクロロエタン又は四塩化炭素ようなハロゲン化炭化水 20素類:テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサンのようなエーテル類が挙げられ、好適には、エーテル類であり、更に好適には、テトラヒドロフランである。

【0073】使用される塩基としては、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属水酸化物;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド;アンモニア水、アンモニア/メタノール溶液のようなアン30モニア溶液をあげることができる。

【0074】反応温度は、0℃乃至60℃であり、好適には、20万至40℃である。

【0075】反応時間は、10分乃至24時間であり、 好適には、1乃至3時間である。

【0076】反応終了後、本反応の目的化合物(1b) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0077】得られた化合物は必要ならば常法、例えば、再結晶またはシリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(2)保護基が「1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基」又は「低級アルキル、低級アルコキシ、ハロゲン、シアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリール基で置換されたメチル基」の場合には、不活性溶剤中、還元剤を用いて行う。

【0078】使用される溶剤としては、メタノール、エタノール、イソプロパノールのようなアルコール類;ジ 50

エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類:トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類:ヘキサン、シクロヘキサンのような脂肪族炭化水素類:酢酸エチル、酢酸プロピルのようなエステル類:酢酸のような有機酸類又はこれらの有機溶媒と水との混合溶媒が好適である。

【0080】圧力は、特に限定はないが、通常1乃至10気圧で行なわれる。

【0081】反応温度は、0℃乃至60℃であり、好適には、20万至40℃である。

【0082】反応時間は、10分乃至24時間であり、 好適には、1乃至3時間である。

【0083】反応終了後、本反応の目的化合物(1b) は、例えば、反応混合物から、還元剤を除去し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、 目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0084】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0085】「3個のアリール基で置換されたメチル基」、すなわち、トリチル基の場合は酸を用いて行うこともできる。

30 【0086】その場合に、使用する溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;メタノール、エタノール、イソプロパノール、tert-ブタノールのようなアルコール類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類;ホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類;酢酸のような有機酸類をあげることができ、好適には、有機酸(特に、酢酸)又はアルコール類(特に、tert-ブタノール)である。

【0087】使用する酸としては、好適には、酢酸又はトリフルオロ酢酸である。

【0088】反応温度は、0℃乃至60℃であり、好適には、20乃至40℃である。

【0089】反応時間は、10分乃至24時間であり、 好適には、1乃至3時間である。

) 【0090】反応終了後、本反応の目的化合物(1b)

thesis" (Theodora W. Greene 著、 1981年、A Wiley-Interscience Publication発行)に記載の方法によって、行うことができる。

50

は、例えば、反応混合物を中和し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0097】特に、保護基が、脂肪族アシル基又は芳香族アシル基の場合には、以下の方法により行うことができる。

(3)保護基が、「シリル基」の場合は、通常、弗化テトラブチルアンモニウム、弗化水素酸、弗化水素酸ーピリジン、弗化カリウムのような弗素アニオンを生成する化合物で処理するか、又は、酢酸、メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸のような有機酸又は塩酸のような無機酸で処理することにより除去できる。

【0098】すなわち、保護基が脂肪族アシル基及び芳香族アシル基の場合は、通常、不活性溶剤中、塩基を反応して行う。

【0091】尚、弗素アニオンにより除去する場合に、 蟻酸、酢酸、プロピオン酸のような有機酸を加えること によって、反応が促進することがある。 10 【0099】使用される溶剤は、水と混合しやすく、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば、特に限定はなく、例えば含水のまたは無水の、メタノール、エタノールのようなアルコール類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド類;メチレンクロリド、クロロホルム、1.2ージクロロエタン又は四塩化炭素ようなハロゲン化炭化水素類;テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサンのようなエーテル類をあげることができ、好適には、アルコール類であり、更に好適には、メタノールである。

【0092】使用される溶媒としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度溶解するものであれば特に限定はないが、好適には、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類;水;酢酸のような有機酸及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。

0 【0100】使用される塩基としては、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属水酸化物;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド;アンモニアをあげることができ、好適には、アンモニアである。

【0093】反応温度は、0℃乃至100℃であり、好適には、20乃至70℃である。

【0 1 0 1】反応温度は、0℃乃至 5 0℃であり、好適には、1 0乃至 4 0℃である。

【0094】反応時間は、5分乃至48時間であり、好適には、1万至24時間である。

【0102】反応時間は、10分乃至24時間であり、 好適には、10乃至15時間である。 反応終了後、例 えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような混 和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有 機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤 を留去することで得られる。

【0095】反応終了後、本反応の目的化合物(1b) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。 得られた化合物は必要ならば常法、例えば、再結晶またはシリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0103】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(A-6工程) 本工程は、不活性溶剤中、A-5工程で得られる化合物(1b)に、脱保護試薬を反応して、本発明の化合物(1c)を製造する工程である。

【0 1 0 4】前述した中間体(3)は、以下に述べるB 乃至D法により、製造することができる。

【0096】脱保護の方法は、保護基の種類によって異なるが、他の副反応を生じない方法であれば、特に限定 40はなく、例えば、"Protective Groups in Organic Syn

10 [0105]

【化8】

B乃至D法中、X及びYは、前述と同意義を示し、R⁹ は、脱離基を形成する基を示し、Eは、エチレン、トリ メチレン又はテトラメチレン基を示し、乙は、単結合、 メチレン又はエチレン基を示す。

【0106】R®の脱離基を形成する基としては、前述 のR⁷にあげられるものと同様のものがあげられ、好適 には、トリフルオロメタンスルホニル基である。

【0 1 0 7】 R¹¹及びR¹²は、同一であって水素原子を 示すか、一緒になって酸素原子を示す。

【0 1 0 8】 R¹⁰は、R¹¹及びR¹²が一緒になって酸素

原子を示す場合には、メチル、エチル、プロピル、イソ プロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tertーブ チルのような炭素数1乃至4個のアルキル基であり、好 適には、メチル基であり、R11及びR12が同一であって 水素原子の場合には、ベンジル基のようなアラルキル 基;メトキシメチル基のようなアルコキシアルキル基; ベンジルオキシメチル基のようなペンジルオキシメチル 基又はベンジルオキシメチル基のようなアラルキルオキ シメチル基:メトキシエトキシメチル基のようなアルコ 50 キシアルコキシアルキル基;トリメチルシリル、t-ブチ

ルジメチルシリル、ジフェニルメチルシリル、ジフェニ ルブチルシリル、ジフェニルイソプロピルシリル、フェ ニルジイソプロピルシリルのようなシリル基をあげるこ とができる。

【0 1 0 9】B法又はC法で使用される原料化合物であ る化合物(7)は、以下の方法で、製造することができ

【0 1 1 0】 すなわち、市販の1, 2, 5, 6-ジイソプロピリ デンD-グルコースを出発原料とし、文献 (R. D. Youssefye h, J. P. H. Verheyden, J. G. Moffatt. J. Org. Chem., 44, 1301-1309 (1979))の方法に準じて、化合物(6)の

「X」の部分が水素原子に相当する化合物を製造し、次 いで、文献 (T. Waga, T. Nishizaki, I. Miyakawa, H. Ohru i, H. Meguro, Biosci. Biotechnol. Biochem., 57, 1 433-1438 (1993)) (X =Bnの場合) の方法に準じて、化 合物(6)を製造することができる。

【0 1 1 1】以下、B乃至D法の各工程につき、詳しく 説明する。

(B法)

(B-1工程) 本工程は、不活性溶剤中、塩基触媒の存 在下、前述の方法で製造される化合物(7)に、脱離基 導入試薬を反応して、化合物(8)を製造する工程であ る。

【0 1 1 2】使用される溶剤としては、例えば、ジメチ ルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド 類:メチレンクロリド、クロロホルム、1,2-ジクロ ロエタン又は四塩化炭素ようなハロゲン化炭化水素類; テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサンの ようなエーテル類をあげることができるが、好適には、 メチレンクロリドである。

【0113】使用される塩基触媒としては、好適には、 トリエチルアミン、ピリジン、ジメチルアミノピリジン のような塩基である。

【0114】使用される脱離基導入試薬としては、好適 には、塩化トリフルオロメタンスルホン酸又は無水トリ フルオロメタンスルホン酸である。

【0115】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒により異なるが、通常、-100℃乃至-5 0℃であり、好適には、-100℃乃至-70℃であ

【0116】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒、反応温度により異なるが、通常、30分乃 至12時間であり、好適には、30分乃至3時間であ

【0117】反応終了後、本反応の目的化合物(8)は、 例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような 混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む 有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶 剤を留去することで得られる。

【0118】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 50 ニウムハイドライドである。

えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 によって更に精製できる。

(B-2工程) 本工程は、不活性溶剤中、B-1工程で 製造される化合物(8)に、シアノ化試薬を反応して、 化合物(9)を製造する工程である。

【0119】使用される溶剤としては、例えば、ジメチ ルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド 類:メチレンクロリド、クロロホルム、1,2-ジクロ ロエタン又は四塩化炭素ようなハロゲン化炭化水素類; 10 テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサンの ようなエーテル類:アセトニトリル:ジメチルスルホキ シド等をあげることができるが、好適には、アミド類 (ジメチルホルムアミド) である。

【0120】使用されるシアノ化試薬としては、例え ば、KCN, NaCN、シアン化トリメチルシラン等をあげる ことができるが、好適には、NaCNである。

【0121】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、シアノ化試薬により異なるが、通常、0℃乃至10 0℃であり、30℃乃至70℃である。

【0122】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、シアノ化試薬、反応温度により異なるが、通常、3 0分乃至12時間であり、好適には、1乃至3時間であ

【0123】反応終了後、本反応の目的化合物(9)は、 例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのような 混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む 有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶 剤を留去することで得られる。

【0124】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 30 えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 によって更に精製できる。

(B-3工程) 本工程は、不活性溶剤中、B-2工程で 製造される化合物 (9) に、還元剤を反応して、化合物 (10)を製造する工程である。

【0125】使用される溶剤としては、例えば、メチレ ンクロリド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン又 は四塩化炭素ようなハロゲン化炭化水素類;ヘキサン、 ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭 化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香 40 族炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエ タン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのような エーテル類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキサノンのよう なケトン類等をあげることができるが、好適には、ハロ ゲン化炭化水素類(特に、メチレンクロリド)である。 【0126】使用される還元剤としては、ジイソプチル アルミニウム水素、トリエトキシアルミニウム水素等を

あげることができるが、好適には、ジイソブチルアルミ

00 (11)を製造する工程である。

ド)である。

【0 1 2 7】反応温度は、使用される原料化合物、溶剤、還元剤により異なるが、−1 0 0℃乃至−5 0℃であり、好適には、−9 0℃乃至−7 0である。

【0128】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、還元剤、反応温度により異なるが、通常、30分乃 至12時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0129】反応終了後、本反応の目的化合物(10) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0 1 3 0】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(B-4工程)本工程は、不活性溶剤中、B-3工程で 製造される化合物(10)に、還元剤を反応して、A法 の原料化合物の一つである化合物(3a)を製造する工 程である。

【0131】使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、セーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロへキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;酢酸等をあげることができるが、好適には、アルコール類(特に、エタノール)である。

【0132】使用される還元剤としては、例えば、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムのような水素化ホウ素アルカリ金属;水素化アルミニウムリチウム、水素化リチウムトリエトキシドアルミニウムのような水素化アルミニウム化合物;ボラン等をあげることができるが、好適には、水素化ホウ素ナトリウムである。

【0 1 3 3】 反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、還元剤により異なるが、通常、0℃乃至 5 0℃であ り、好適には、1 0乃至 4 0℃である。

【0134】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、還元剤、反応温度により異なるが、通常、10分乃 至12時間であり、好適には、30分乃至5時間であ る。

【0135】反応終了後、本反応の目的化合物(3a) は、例えば、還元剤を分解し、反応混合物を濃縮し、水 と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗 後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネ シウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0136】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(C法)

(C-1工程) 本工程は、不活性溶剤中、前述の方法で 製造される化合物(7)に、酸化剤を反応して、化合物 50

【0137】使用される溶剤としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪 族炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレンのような 芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;蟻酸エチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキサノンのようなケトン類;をあげることができるが、好適には、ハロゲン化炭化水素類(特に、メチレンクロリ

56

【0138】使用される酸化剤としては、スワン(Swern)酸化用試薬、デスマーチン(Dess-Martin)酸化用試薬、ピリジン塩酸塩・三酸化クロム錯体(ピリジニウムクロロクロメート、ピリジニウムジクロメート)のような三酸化クロム錯体等をあげることができるが、好適な試薬としては、スワン酸化用試薬(すなわち、ジメチルスルホキシドーオキザリルクロリド)である。

【0 1 3 9】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、酸化剤により異なるが、通常、-100℃乃至-5 0℃であり、好適には、-100乃至-70℃である。

【0 1 4 0 】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、酸化剤、反応温度によって異なるが、通常、30分 乃至12時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0141】反応終了後、本反応の目的化合物(11) は、例えば、酸化剤を分解し、反応混合物を濃縮し、水 と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗 後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネ シウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0142】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(C-2工程) 本工程は、不活性溶剤中、C-1工程で 製造される化合物(11)に、増炭素試薬を反応して、 40 化合物(12)を製造する工程である。

【0143】使用される溶剤としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪 族炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレンのような 芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;蟻酸エチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテ

には、10乃至40℃である。

ルのようなエーテル類;アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキ サノンのようなケトン類;をあげることができるが、好 適には、ハロゲン化炭化水素類(特に、メチレンクロリ ド)である。

【0144】使用される試薬としては、ウィッティヒ(W ittig)試薬、ホーナー・エモンズ(Horner-Emmons)試 薬、ピターソン(Peterson)反応試薬、TiCl4-CH2Cl2-Zn 系反応剤、テーベ(Tebbe)試薬等をあげることができる が、好適には、ウィッティヒ試薬、ホーナー・エモンズ 10 試薬及びテーベ試薬である。

【0145】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、増炭素試薬により異なるが、通常、-20℃乃至2 0℃であり、好適には、0℃である。

【0146】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、増炭素試薬、反応温度によって異なるが、30分乃 至12時間、好適には、1乃至5時間である。

【0147】反応終了後、本反応の目的化合物(12) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0148】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 によって更に精製できる。

(C-3工程) 本工程は、不活性溶剤中、C-2工程で 製造される化合物(12)のオレフィンの末端炭素に選 択的に水酸基を導入して、化合物(3a)を製造する工 程である。

【0149】使用される溶剤としては、例えば、ヘキサ ン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪 族炭化水素類:ベンゼン、トルエン、キシレンのような 芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、 四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロ ロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;蟻酸エチ ル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエ チルのようなエステル類:ジエチルエーテル、ジイソプ ロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジ メトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテ ルのようなエーテル類;アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソプチルケトン、イソホロン、シクロヘキ サノンのようなケトン類をあげることができるが、好適 には、エーテル類(特に、テトラヒドロフラン)であ

【0150】使用される反応試薬としては、ボラン、ジ シアミルボラン、セキシルボラン、9-BBN(9-ボラビシク ロ[3.3.1] ノナン)等をあげることができるが、好適に は、9-BBNである。

【0151】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、試薬により異なるが、0℃乃至50℃であり、好適 50 (D−2工程)本工程は、不活性溶剤中、D−1工程で

【0152】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、試薬、反応温度により異なるが、通常、6乃至48 時間であり、好適には、12乃至24時間である。

58

【0 1 5 3】反応終了後、本反応の目的化合物(3 a) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0154】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 によって更に精製できる。

(D法)

(D-1工程) 本工程は、不活性溶剤中、C-1工程で 製造される化合物(11)に、増炭素試薬を反応して、 化合物(13)を製造する工程である。

【0155】使用される溶剤としては、例えば、ヘキサ ン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪 族炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレンのような 芳香族炭化水素類:メチレンクロリド、クロロホルム、 四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロ ロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類; 蟻酸エチ ル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸プチル、炭酸ジエ チルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプ ロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジ メトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテ ルのようなエーテル類:アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソプチルケトン、イソホロン、シクロヘキ サノンのようなケトン類をあげることができるが、好適 には、エーテル類(特に、テトラヒドロフラン)等をあ げることができるが、さらに好適には、ハロゲン化炭化 水素類(特に、メチレンクロリド)である。

【0156】使用される増炭素試薬としては、ウィッテ ィヒ(Wittig)試薬、ホーナー・エモンズ(Horner-Emmon s) 試薬等をあげることができる。

【0157】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、試薬により異なるが、通常、-20℃乃至40℃で あり、好適には、0乃至20℃である。

【0158】反応時間は、使用される原料化合物、溶 40 剤、試薬、反応温度によって異なるが、30分乃至12 時間、好適には、1乃至5時間である。

【0159】反応終了後、本反応の目的化合物(13) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0 1 6 0】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 えば再結晶、またはシリカゲルカラムクロマトグラフィ 一等によって更に精製できる。

製造される化合物(13)に、還元剤を反応して、化合物(14)を製造する工程である。

【0 1 6 1】本工程は、 A-5工程の(2)に準じて実施することができる。但し、 R^{10} が、置換基を有していてもよいベンジル基で、かつ、 R^{11} 及び R^{12} が水素原子である場合には、この工程により、化合物(3 b)を直接製造することができる。

(D-3工程)本工程は、不活性溶剤中、D-2工程で製造される化合物(14)に、還元剤を反応させて、A 法の原料化合物の一つである化合物(3b)を製造する 10 工程である。

(a) R¹¹とR¹²とが一緒になって酸素原子である場合使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nープタノール、イソブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;酢酸等をあげることができるが、好適には、アルコール類(特に、エタノール)である。

【0162】使用される還元剤としては、例えば、水素 20 化ホウ素リチウムのような水素化ホウ素アルカリ金属; 水素化アルミニウムリチウム、水素化リチウムトリエトキシドアルミニウムのような水素化アルミニウム化合物; ボラン等をあげることができるが、好適には、ボランあるいは水素化アルミニウムリチウムである。

【0 1 6 3】反応温度は、使用される原料化合物、溶 剤、還元剤により異なるが、通常、0℃乃至50℃であ り、好適には、10乃至40℃である。

【0164】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、還元剤、反応温度により異なるが、通常、10分乃 30 至12時間であり、好適には、30分乃至5時間であ る

【0165】反応終了後、本反応の目的化合物(3b) は、例えば、還元剤を分解し、反応混合物を濃縮し、水 と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗 後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネ シウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0166】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(b) R¹¹とR¹²とが水素の場合でR¹⁰がベンジル基以外の場合

R¹⁰がシリル基の場合には、A-5工程の(3)の方法

60

に準じて実施することができる。

【0167】R¹⁰がベンジル基のようなアラルキル基;メトキシメチル基のようなアルコキシアルキル基;ベンジルオキシメチル基のようなベンジルオキシメチル基又はベンジルオキシメチル基のようなアラルキルオキシメチル基;メトキシエトキシメチル基のようなアルコキシアルコキシアルキル基等の場合には、酸触媒を用い、その場合に使用される酸触媒としてはpートルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、ジクロロ酢酸のような有機酸、BF₃、AlCl₃のようなルイス酸をあげることが出来る。

【0168】使用される溶剤としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類;ホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーメチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類;硫化炭素等をあげることが出来る。

【0 1 6 9】反応温度は、使用される原料化合物、溶剤、酸触媒により異なるが、通常、0℃乃至 5 0℃であり、好適には、10乃至 4 0℃である。

【0170】反応時間は、使用される原料化合物、溶 剤、酸触媒、反応温度により異なるが、通常、10分乃 至12時間であり、好適には、30分乃至5時間であ る。

【0171】反応終了後、本反応の目的化合物(3b) は、例えば、反応混合物を中和し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0172】得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0173】本発明の化合物(1)を用い、以下に述べるE法により、修飾ヌクレオシドを含むオリゴヌクレオチド又はそのチオエート誘導体を製造することができる。

【0174】 【化9】

62

E法中、A及びBは、前述と同意義を示し、R¹³は、水 酸基の保護基(特に、メトキシ基で置換されていてもよ いトリチル基)を示し、R14は、ホスホニル基、後述す るモノ置換ークロロ(アルコキシ)ホスフィン類又はジ 置換ーアルコキシホスフィン類を反応することにより形 成される基を示す。

(E法)

(E-1工程)

本工程は、不活性溶剤中、A法で製造される化合物

(1)に、保護化試薬を反応して、化合物(15)を製 30 造する工程である。

【0175】使用される溶剤としては、好適には、ベン ゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類; メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロ ロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのような ハロゲン化炭化水素類;蟻酸エチル、酢酸エチル、酢酸 プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル 類:ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テト ラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエ チレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル 類:アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル ケトン、イソホロン、シクロヘキサノンのようなケトン 類:ニトロエタン、ニトロベンゼンのようなニトロ化合 物類;アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニ トリル類;ホルムアミド、ジメチルホルムアミド(DM F)、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホロト リアミドのようなアミド類:ジメチルスルホキシド、ス ルホランのようなスルホキシド類:トリメチルアミン、 トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン等の脂肪族三 級アミン類;ピリジン、ピコリンのような芳香族アミン 50 によって更に精製できる。

などがあげられ、さらに好適には、ハロゲン化炭化水素 類(特にメチレンクロリド)、芳香族アミン(特にピリ ジン)である。使用される保護化試薬としては、5'位 のみを選択的に保護でき、酸性、中性の条件下、除去で きるものであれば、特に制限はないが、好適には、トリ チルクロリド、モノメトキシトリチルクロリド、ジメト キシトリチルクロリドのようなトリアリールメチルハラ イド類である。保護化試薬としてトリアリールメチルハ ライド類を用いる場合には、通常、塩基を用いる。その 場合において、使用される塩基としては、ピリジン、ジ メチルアミノピリジン、ピロリジノピリジン等の複素環 アミン類、トリメチルアミン、トリエチルアミン等の脂 肪族三級アミン類があげられ、好適には、ピリジン、ジ メチルアミノピリジン、ピロリジノピリジンである。

【0176】溶剤として、液状の塩基を用いる場合に は、該塩基自体が脱酸剤として働くので、改めて塩基を 加える必要はない。

【0177】反応温度は、使用される原料、試薬、溶剤 などにより通常0乃至150℃であり、好適には20乃 至100℃である。また、反応時間は使用される原料、 溶剤、反応温度などにより異なるが、通常1乃至100 時間であり、好適には、2乃至24時間である。

【0178】反応終了後、本反応の目的化合物(15) は、例えば、反応混合物を濃縮し、水と酢酸エチルのよ うな混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を 含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥 後、溶剤を留去することで得られる。

【0179】得られた化合物は、必要ならば、常法、例 えば、再結晶、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等 (E-2工程) 本工程は、不活性溶剤中、E-1工程で製造される化合物(15)に、アミダイト化に通常用いるモノ置換-クロロ(アルコキシ)ホスフィン類又はジ置換-アルコキシホスフィン類を反応して、化合物(16)を製造する工程である。

【0180】使用される溶剤としては、反応に影響を与えないものであれば、特に限定はないが、好適には、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサンのようなエーテル類:メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロ10ペンゼンのようなハロゲン化炭化水素類が挙げられる。

【0181】使用されるモノ置換ークロロ(アルコキシ)ホスフィン類としては、例えば、クロロ(モルホリノ)シアナトキシホスフィン、クロロ(ジメチルアミノ)メトキシホスフィン、クロロ(ジメチルアミノ)シアノエトキシホスフィン、クロロ(ジイソプロビルアミノ)シアノエトキシホスフィンのようなホスフィン類があげられ、好適には、クロロ(モルホリノ)メトキシホスフィン、クロロ(ジイソプロビルアミノ)シアノエトキシホスフィン、クロロ(ジイソプロビルアミノ)メトキシホスフィン、クロロ(ジイソプロビルアミノ)シアノエトキシホスフィンである。

【0182】モノ置換ークロロ(アルコキシ)ホスフィン類を用いる場合には、脱酸剤が使用され、その場合に、使用される脱酸剤としては、ピリジン、ジメチルアミノビリジンのような複素環アミン類、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロビルアミンのような脂肪族アミン類があげられるが、好適には、脂肪族アミ 30ン類(特にジイソプロビルアミン)である。

【0183】使用されるジ置換ーアルコキシホスフィン類としては、例えば、ビス(ジイソプロピルアミノ)シアノエトキシホスフィン、ビス(ジエチルアミノ)メタンスルホニルエトキシホスフィン、ビス(ジイソプロピルアミノ)(2,2,2-トリクロロエトキシ)ホスフィン、ビス(ジイソプロピルアミノ)(4-クロロフェニルメトキシ)ホスフィンのようなホスフィン類をあげることができ、好適には、ビス(ジイソプロピルアミノ)シアノエトキシホスフィンである。

【0184】ジ置換ーアルコキシホスフィン類を用いる場合には、酸が使用され、その場合に、使用される酸としては、好適には、テトラゾール、酢酸又はpートルエンスルホン酸である。

【0185】反応温度は、特に限定はないが、通常0乃 至80℃であり、好適には、室温である。

【0186】反応時間は、使用する原料、試薬、温度等により異なるが、通常、5分乃至30時間であり、好適には、室温で反応した場合、30分乃至10時間である。

64

【0187】反応終了後、本反応の目的化合物(16)は、目的化合物は、例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には、濾過により除去した後、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば、再結晶、再沈殿又はクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0188】又は、本工程は、不活性溶剤中(好適には、メチレンクロリドのようなハロゲン化炭化水素類)、E-1で製造される化合物(15)に、トリスー(1,2,4-トリアゾリル)ホスファイトを反応した後、水を加えて、H-ホスホネート化して、化合物(16)を製造する工程である。

【0189】反応温度は、特に限定はないが、通常−2 0乃至100℃であり、好適には、10乃至40℃であ る。

【0190】反応時間は、使用する原料、試薬、温度等により異なるが、通常、5分から30時間であり、好適には、室温で反応した場合、30分である反応終了後、本反応の目的化合物(16)は、例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には、濾過により除去した後、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば、再結晶、再沈殿又はクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

(E-3工程)本工程は、少なくとも1つ以上のE-2で製造される化合物(16)、及び、所望のヌクレオチド配列のオリゴヌクレオチド類縁体を製造するのに必要な市販のホスホロアミダイト試薬等を使用して、通常の方法により、DNA自動合成機上、目的のオリゴヌクレオチド類縁体を製造する工程である。

【0 1 9 1】所望のヌクレオチド配列を持つオリゴヌクレオチド類縁体は、DNA合成機、例えばバーキンエルマー社のホスホロアミダイト法によるモデル 3 9 2 などを用いて文献 (Nucleic AcidsResearch, 12, 4539(1984)) 記載の方法に準じて合成することが出来る。

【0192】又、所望により、チオエート化する場合は、硫黄のほかテトラエチルチウラムジスルフィド(TETD、アプライドバイオシステムズ社)、Beaucage試薬(ミリボア社)等の3価のリン酸に反応してチオエートを形成する試薬を用い、文献(Tetarhedron Letters, 32, 3005(1991)、J. Am. Chem. Soc., 112, 1253(1990))記載の方法に準じてチオエート誘導体を得る事が出来る。

【0193】得られる粗製のオリゴヌクレオチド類縁体 50 は、オリゴパック(逆相クロマトカラム)を使用して、 精製し、精製物の純度をHPLCで分析することにより 確認することができる。

【0 1 9 4】得られるオリゴヌクレオチド類縁体の鎖長は、ヌクレオシド単位として、通常、2乃至50個であり、好適には、10乃至30個である。

【0195】得られたオリゴヌクレオチド類縁体の相補 鎖形成能及びヌクレアーゼ酵素耐性は、以下の方法に従 い、調べることができる。

(試験方法1) 得られた種々のオリゴヌクレオチド類縁体と、相補的な配列を有する天然のDNAあるいはRNAからなるオリゴヌクレオチドとをアニーリング処理し、融解温度(Tm値)を測定することにより、本発明のオリゴヌクレオチド類縁体の相補DNAおよびRNAに対するハイブリッド形成能を調べる。

【0196】リン酸ナトリウム緩衝液オリゴヌクレオチド類縁体と天然型相補オリゴヌクレオチドを同量加えたサンプル溶液を、沸騰水中に浴し、時間をかけてゆっくり室温まで冷却する(アニーリング)。分光光度計(例えば、島津 UV-2100PC)のセル室内で、サンプル溶液を20℃から90℃まで温度を少しずつ上昇させ、260nmにおける紫外線吸収を測定する。

(試験方法2) ヌクレアーゼ酵素耐性の測定

オリゴヌクレオチドを緩衝液中にて、ヌクレアーゼを加えて加温する。ヌクレアーゼとしては、蛇毒ホスホジエステラーゼ、エンドヌクレアーゼP1、エンドヌクレアーゼS1等が用いられる。緩衝液としては、酵素に適する緩衝液であれば制限はないが、蛇毒ホスホジエステラーゼの場合トリス - 塩酸緩衝液、エンドヌクレアーゼP1の場合酢酸ナトリウムバッファー等が使用される。また必要に応じて緩衝液に金属イオンを加える。金属イオンとしては、蛇毒ホスホジエステラーゼの場合Mg²+、エンドヌクレアーゼの場合Zn²+等が用いられる。反応温度は0~100℃が好適であり、さらに30~50℃が好適である。

【0197】一定時間後、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)を加え、100℃で2分間加熱することにより、反応を停止させる。

【0198】オリゴヌクレオチドの残量の定量には、オリゴヌクレオチドをラジオアイソトープ等で標識し切断反応生成物をイメージアナライザー等で定量する方法、切断反応生成物を逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で定量する方法、切断反応生成物を色素(エチジウムブロマイド等)で染色し、コンピューターを用いた画像処理により定量する方法などが用いられる。

【0199】本発明の一般式(2)で表される構造を1 又は2以上含有するオリゴヌクレオチド類縁体の投与形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口投与又は注射剤若しくは坐剤等による非経口投与を示し、これらの製剤は、賦形剤(例えば、乳糖、白糖、葡萄糖、マンニトール、ソ

66 ルビトールのような糖誘導体;トウモロコシデンプン、 バレイショデンプン、α澱粉、デキストリンのような澱 粉誘導体;結晶セルロースのようなセルロース誘導体; アラビアゴム;デキストラン;プルランのような有機系 賦形剤:及び、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、 珪酸カルシウム、メタ珪酸アルミン酸マグネシウムのよ うな珪酸塩誘導体;燐酸水素カルシウムのような燐酸 塩;炭酸カルシウムのような炭酸塩;硫酸カルシウムの ような硫酸塩等の無機系賦形剤を挙げることができ る。)、滑沢剤(例えば、ステアリン酸、ステアリン酸 カルシウム、ステアリン酸マグネシウムのようなステア リン酸金属塩;タルク;コロイドシリカ;ピーガム、ゲ イ蝋のようなワックス類;硼酸;アジピン酸;硫酸ナト リウムのような硫酸塩;グリコール;フマル酸;安息香 酸ナトリウム;DLロイシン;脂肪酸ナトリウム塩;ラ ウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグネシウムのよ うなラウリル硫酸塩;無水珪酸、珪酸水和物のような珪 酸類;及び、上記澱粉誘導体を挙げることができ る。)、結合剤(例えば、ヒドロキシプロピルセルロー ス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニル ピロリドン、マクロゴール、及び、前記賦形剤と同様の 化合物を挙げることができる。)、崩壊剤(例えば、低 置換度ヒドロキシプロビルセルロース、カルボキシ基メ チルセルロース、カルポキシ基メチルセルロースカルシ ウム、内部架橋カルボキシ基メチルセルロースナトリウ ムのようなセルロース誘導体;カルボキシ基メチルスタ ーチ、カルポキシ基メチルスターチナトリウム、架橋ポ リビニルピロリドンのような化学修飾されたデンプン・ セルロース類を挙げることができる。)、安定剤(メチ ルパラベン、プロピルパラベンのようなパラオキシ安息 香酸エステル類:クロロブタノール、ベンジルアルコー ル、フェニルエチルアルコールのようなアルコール類; 塩化ベンザルコニウム;フェノール、クレゾールのよう なフェノール類;チメロサール;デヒドロ酢酸;及び、 ソルビン酸を挙げることができる。)、矯味矯臭剤(例

方法で製造される。
【0200】その使用量は症状、年齢、投与方法等により異なるが、例えば、経口投与の場合には、1回当り、下限として、0.01mg/kg 体重(好ましくは、0.1mg/kg 体重)、上限として、1000mg/kg 体重(好ましくは、100mg/kg 体重)を、静脈内投与の場合には、1回当り、下限として、0.001mg/kg 体重(好ましくは、0.01mg/kg 体重)、上限として、100mg/kg 体重(好ましくは、10mg/kg 体重)を1日当り1乃至数回症状に応じて投与することが望ましい。以下、実施例、参考例及び試験例をあげて、本発明をさらに詳しく説明する。

えば、通常使用される、甘味料、酸味料、香料等を挙げることができる。)、希釈剤等の添加剤を用いて周知の

[0201]

40

50

【実施例】(実施例1)

<u>3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン</u>(例示化合物番号2-34)

参考例11で得られた化合物(6.80g、8.86mmol)を、ピリジン(136ml)に溶解し、0℃に冷却後、2N水酸化ナトリウム水溶液(68ml)を加え、室温で1時間撹拌した。反応終了後、反応液に20%酢酸水を滴下し、反応液を中和した後、クロロホルムで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。溶媒を減圧下留去した後、残渣をシリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール = 100:3)、目的化合物(3.33g、6.02mmol、68%)を得た。

【 0 2 0 2 】 ¹ H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 8.64 (2H, br s), 7.89 (2H, d, 7.6Hz), 7.64-7.60 (1H, m), 7.54-7.5 1 (2H, m), 7.48-7.37 (3H, m), 7.36-7.26 (8H, m), 6.18 (1H, s), 4.70 (1H, d, 11Hz), 4.60 (1H, d, 11Hz), 4.55 (1H, d, 11Hz), 4.46 (1H, d, 2.9Hz), 4.42 (1H, d, 11Hz), 4.10-4.02 (2H, m), 3.89 (1H, d, 2.9Hz), 3.75 (1H, d, 11Hz), 3.62 (1H, d, 11Hz), 2.34-2.26 (1H, m), 1.3 9-1.36 (1H, m). FAB-MAS (mNBA) : 554 (M+H) ⁺

(実施例2)

<u>2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン</u>(例示化合物番号2-225)

実施例1で得られた化合物(2.06g、3.72mm ol)を無水ジクロロメタン(317ml)に溶解し、-78 \mathbb{C} に冷却したところでトリクロロボラン(1.0 M in ジクロロメタン)(31.7ml)を滴下した。-78 \mathbb{C} で一時間攪拌したあと、-20 \mathbb{C} までゆっくり昇温し、反応容器を氷一食塩のバスにつけて-20 \mathbb{C} から-10 \mathbb{C} の間で2時間攪拌した。メタノール(12ml)をゆっくり滴下し、10分間攪拌した後、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液を少量ずつ加えて \mathbb{C} $\mathbb{$

L 0 2 0 3 **J** ¹ H-NMR (500MHz, DMSO-d₆) : 11. 23 (1H, br s), 8. 70 (1H, d, 7. 2Hz), 8. 00 (2H, d, 7. 5Hz), 7. 3-6 (4H, m), 5. 97 (1H, s), 5. 35 (1H, dd, 5 and 10Hz), 4. 10 (1H, d d, 5 and 10Hz), 4. 03 (1H, d, 3. 2Hz), 3. 95-3. 85 (2H, m) 3. 83 (1H, d, 3. 2Hz), 3. 65-3. 51 (2H, m), 2. 06-1. 98 (1H, m), 1. 26 (1).

FAB-MAS (mNBA) : 374 (M+H) +

(実施例3)

<u>2'-O,4'-C-エチレン-シチジン</u> (例示化合物番号 2 - 3)

実施例 2 で得られた化合物 (0.1g、0.268mm ol) を飽和アンモニア - メタノール溶液 (12ml) に溶解し、一晩置いた。溶媒を留去して、白色固体の目

的物(0.054g、75%)を得た。

[0 2 0 4] 1 H-NMR (500MHz, DMSO-d₆) : 8.18 (1H, d, 7.4Hz), 7.10 (2H, br), 5.84 (1H, s), 5.69 (1H, d, 7.6 Hz), 5.27-5.24 (2H, m), 3.86 (1H, d, 3.2Hz), 3.90-3.78 (2H, m), 3.76 (1H, d, 3.2Hz), 3.56 (1H, dd, 5.5 and 12Hz), 3.49 (1H, dd, 5.5 and 12Hz), 2.01-1.93 (1H, dt, 7.5 and 12Hz), 1.22 (1H, dd, 3.6 and 13Hz). FAB-MAS (mNBA) : 270 (M+H) $^+$

68

(実施例4)

10 5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン (例示化合物番号2-39) 実施例2で得られた化合物(1.29g、3.46mm ol)を無水ビリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無水ビリジン(26ml)に溶解した。これに4,4'-ジメトキシトリチルクロライド(1.76g、5.18m mol)を添加し、室温で一晩攪拌した。反応溶液に少量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、水を加え,クロロホルムで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下 20 濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール=100:5)、無色アモルファス状の目的物(2.10g、3.11mmol、90%)を得た。

[0 2 0 5] 1 H-NMR (270MHz, DMSO-d₆) : 11.27 (1H, br s), 8.59 (1H, m), 6.92-8.01 (19H, m), 6.03 (1H, s), 5.56 (1H, m), 4.17 (1H, m), 4.08 (1H, m), 3.86 (2H, m), 3.77 (6 H, s), 3.24 (2H, m), 1.98 (1H, m), 1.24 (1H, m). FAB-MAS (mNBA):676 (M+H) $^+$

(実施例5)

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイルシチジン-3'-O-(2-シアノエチル N. N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト (例示化 合物番号2-235)

実施例4で得られた化合物(6.53g、9.66mm ol)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流下、無水ジクロロメタン(142ml)に溶解し、N,Nージイソプロピルアミン(2.80ml,16.1mmol)を加えた。氷冷下、2ーシアノエチルN,Nージイソプロピルクロロホスホロアミダイト(2.16ml,409.66mmol)を滴下し、室温で6時間攪拌した。反応溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:トリエチルアミン=50:1~ジクロロメタン:酢酸エチル:トリエチルアミン=60:30:1)、淡白色状の目的物(7.10g、8.11mmol、84%)を得た。

【 0 2 0 6 】 ¹ H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.1-1.2(12H, m), 1.35(1H, m), 2.11(1H, m), 2.3(2H, m), 3.35-3.7(6 H, m), 3.8(6H, m), 3.9-4.1(2H, m), 4.33(1H, m), 4.45(1

H, m), 6. 23 (1H, s), 6. 9 (4H, m), 7. 3-7. 9 (15H, m), 8. 7-8. 8 (1H, m)

(実施例6)

<u>3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレン5-メチルウリジン</u>(例示化合物番号2-22)

参考例10で得られた化合物(418mg、0.62mmol)を、ピリジン:メタノール:水=65:30:5の混合溶液(5ml)に溶解した。そこへ、2N水酸化ナトリウム/同混合溶液(5ml)を0℃で加え、室温で15分攪拌した。

【0207】反応終了後、1N塩酸で反応液を中和し、 酢酸エチル(約30ml)を加えて、分液し、有機層を 炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約30ml)、飽和食 塩水(約30ml)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで 乾燥した。

【0208】減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ヘキサン:酢酸エチル=1:1)、アモルファス状無色物質(228mg、0.49mmol,79%)を得た。

[0 2 0 9] 1H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.35(1H, d, 1 20 3Hz), 1.41(3H, s), 2.28(1H, dt, 9.4 and 13Hz), 3.60 (1H, d, 11Hz), 3.76(1H, d, 11Hz), 3.94(1H, d, 3.0Hz), 4.10(1H, d, 7.0Hz), 4.14(1H, d, 7.0Hz), 4.31(1 H, d, 3.0Hz), 4.51(1H, d, 12Hz), 4.54(1H, d, 12Hz), 4.58(1H, d, 12Hz), 4.75(1H, d, 12Hz), 6.06(1H, s), 7.3(10H, m), 7.91(1H, s), 8.42(1H, brs). FAB-M AS (mNBA): 465 (M+H) +

(実施例7)

<u>2'-O,4'-C-エチレン5-メチルウリジン</u>(例示化合物 番号2-2)

実施例6で得られた化合物(195mg、0.42mmol)をメタノール(10ml)に溶解し、得られた 反応液を、水素気流下、常圧で5時間攪拌した。

【0210】反応終了後、触媒を濾過し、濾液の溶媒を減圧下留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール=10:1)、白色粉末(76mg、0.268mmo1,64%)を得た。

[0 2 1 1] 1 H-NMR (400MHz, CD₃OD) : 1.33(1H, dd, 3.8 and 13Hz), 1.86(3H, d, 0.9Hz), 1.94(1H, ddd, 7.5, 11.7 and 13Hz), 3.68(1H, d, 12Hz), 3.75(1H, d, 12Hz), 3.9-4.0(2H, m), 4.05(1H, d, 3.2Hz), 4.09(1H, d, 3.2Hz), 6.00(1H, s), 8.28(1H, d, 1.1Hz). FAB-MAS (mNBA) : 285 (M+H) $^{+}$

(実施例8)

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-5 <u>ーメチルウリジン</u>(例示化合物番号2-27) 実施例7で得られた化合物(1.45g、5.10mm ol)を無水ピリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無水 ピリジン(44ml)に溶解した。これに4,4'-ジ メトキシトリチルクロライド(2.59g、7.65mmol)を添加し、室温で一晩攪拌した。反応溶液に少量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、水を加え,クロロホルムで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール=100:10)、無色アモルファス状の目的物(2.42g、4.13mmol、81%)を得た。

70

[0 2 1 2] 1 H-NMR (270MHz, DMS0-d₆) : 11.36 (1H, s), 7.68 (1H, s), 6.90-7.44 (13H, m), 5.89 (1H, s), 5.55 (1H, d), 4.09 (1H, m), 4.04 (1H, d), 3.82 (2H, m), 3.74 (6 H, s), 3.19 (2H, m), 1.99 (1H, m), 1.36 (1H, m), 1.17 (3H, s). FAB-MAS (mNBA):587 (M+H) $^+$

(実施例9)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-5</u> <u>-メチルウリジン-3'-O-(2-シアノエチル N.N</u> <u>-ジイソプロビル)ホスホロアミダイト</u>(例示化合物番 号 2 - 2 3 4)

実施例 8 で得られた化合物 (4.72g、8.05mm ol)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流下、無水ジクロロメタン(142ml)に溶解し、N,Nージイソプロピルアミン(2.80ml,16.1mmol)を加えた。氷冷下、2ーシアノエチルN,Nージイソプロピルクロロホスホロアミダイト(2.16ml,9.66mmol)を滴下し、室温で6時間攪拌した。反応溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ヘキサン:酢酸エチル:トリエチルアミン=50:50:1~ヘキサン:酢酸エチル:トリエチルアミン=30:60:1)、無色アモルファス状の目的物(5.64g、7.17mmol、89%)を得た。

[0 2 1 3] 1 H-NMR (400MHz, CDC1 $_3$) :1.1-1.2(15H, m), 1.4(1H, m), 2.08(1H, m), 2.4(2H, m), 3.2-4.0(14H, m), 4.38(2H, m), 4.47(1H, m), 6.06(1H, s), 6.8-6.9(4 H, m), 7.2-7.5(9H, m), 7.91(1H, m). FAB-MAS (mNBA):787(M+H) $^+$

(実施例10)

40 3'.5'-ジ-Q-ベンジル-2'-Q.4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン (例示化合物番号1-23) 参考例12で得られた化合物 (238mg、0.30mmol)を、ピリジン:メタノール:水=65:30:5の混合溶液 (5ml)に溶解した。そこへ、2N水酸化ナトリウム/同混合溶液 (5ml)を0℃で加え、室温で15分攪拌した。

【0214】反応終了後、1N塩酸で反応液を中和し、 酢酸エチル(約30ml)で抽出し、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約30ml)、飽和食塩水(約30m 50 1)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧 下、溶媒を留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン: メタノール=50:1)、アモルファス状無色物質(133mg、0.23mmol、78%)を得た。

[0 2 1 5] ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.44(1H, d, 1 3Hz), 2.31(1H, dd, 13 and 19Hz), 3.56(1H, d, 11Hz), 3.70(1H, d, 11Hz), 4.10(2H, m), 4.24(1H, s), 4.45(1H, d, 12Hz), 4.53-4.67(4H, m), 6.52(1H, s), 7.3 (10H, m), 7.53(2H, m), 7.62(1H, m), 8.03(2H, d, 7.6Hz), 8.66(1H, s), 8.78(1H, s), 9.00(1H, brs). FAB 10 -MAS (mNBA):578(M+H) ⁺

(実施例11)

<u>2'-O.4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン</u>(例 示化合物番号1-178)

窒素気流下、実施例 10で得られた化合物(116mg、0.20mmol)を無水ジクロロメタン5mlに溶解し、-78℃に冷却した。そこに、1M-三塩化ホウ素/ジクロロメタン溶液(1.5ml、1.5mmol)をゆっくり滴下し、-78℃で3時間撹拌した。さらに、1M-三塩化ホウ素/ジクロロメタン溶液(1.5ml、1.5mmol)を加え、2時間撹拌した。次いで、室温にゆっくり昇温し、再び-78℃に急冷した後、メタノール(5ml)を加え、再度、室温にゆっくり昇温した。

【0216】反応終了後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール=9:1)、白色粉末(49mg、0.17mmol、84%)を得た。

[0 2 1 7] 1 H-NMR (400MHz, CD₃OD) : 1.45(1H, dd, 4.3 and 13Hz), 2.12(1H, m), 3.72(1H, d, 12Hz), 3.7 9(1H, d, 12Hz), 4.04(1H, dd, 7.3 and 12Hz), 4.15(1 H, dt, 4.3 and 9.4Hz), 4.36(1H, d, 3.2Hz), 4.43(1 H, d, 3.2Hz), 6.57(1H, s), 7.57(2H, m), 7.66(1H, m), 8.09(2H, d, 8.0Hz), 8.72(1H, s), 8.85(1H, s). FAB-MAS (mNBA):398 (M+H) $^{+}$

(実施例12)

<u>2'-O,4'-C-エチレンアデノシン</u>(例示化合物番号1-7)

実施例11で得られた化合物(14mg、0.035mmol)を、飽和アンモニア/メタノール溶液(1ml)に溶解し、一晩放置した。

【0218】反応終了後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール=10:1)、白色粉末(10mg、0.034mmol、98%)を得た。【0219】 'H-NMR(400MHz、CD₃OD): 1.32(1H, dd, 4 and 13Hz), 2.04(1H, dt, 7.4 and 12Hz), 3.53(1H, dd, 5 and 12Hz), 3.61(1H, dd, 5.2 and 12Hz), 3.90(1H, dd, 7.4 and 12Hz), 4.15(1H, d, 3.1Hz), 4.21(1H, d, 3.1Hz), 5.27(1H,

t, 5. 2Hz), 5. 39 (1H, d, 3. 1Hz), 6. 33 (1H, s), 7. 29 (2

H, s), 7.66 (1H, m), 8.14 (1H, s), 8.42 (1H, s). FAB-MAS (mNBA): 294 (M+H) $^+$ UV (λ max): 260 (pH7), 260 (pH 1), 258 (pH13)

72

(実施例13)

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン (例示化合物番号<math>1-31) 実施例11で得られた化合物(14 m g、0.035 m mol)を無水ピリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無水ピリジン(1 ml)に溶解した。これに4.4' - ジメトキシトリチルクロライド(18 m g、0.053 m mol)を添加し、40 ℃、5 時間攪拌した。反応溶液に少量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、水を加え,クロロホルムで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール=100:5)、無色アモルファス状の目的物(18 m g、0.026 m mol、73%)を得た。

20 【 0 2 2 0 】 ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) :1.63(1H, m), 2. 14(1H, 7.5, 12, and 13Hz), 3.37(1H, d, 11Hz), 3.41(1H, d, 11Hz), 3.79(6H, s), 4.10(2H, m), 4.48(1H, d, 3.3Hz), 4.59(1H, d, 3.3Hz), 6.54(1H, s), 6.85(4H, m), 7.2-7.6(12H, m), 8.02(2H, m), 8.45(1H, s), 8.82(1H, s), 9.02(1H, brs). FAB-MAS (mNBA):700(M+H) ⁺

(実施例14)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-6-N-ベンゾイルアデノシン-3'-O-(2-シアノエチルN.N-ジイソプロピル)ホスホロアミダイト</u>(例示化合物番号1-186)

実施例 1 3 で得られた化合物(1 6 mg、0. 0 2 3 m mo 1)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流下、無水ジクロロメタン(0. 5 m 1)に溶解し、テトラゾールN,Nージイソプロピルアミン塩(1 0 mg)を加えた。氷冷下、2 ーシアノエチルN,N,'N,'Nーテトライソプロピルホスホロアミダイト(約 2 0 μ 1)を滴下し、室温で一晩攪拌した。反応溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:酢酸エチル=2: 1)、白色固体の目的物(2 0 mg、0. 0 2 2 mm o 1、9 7%)を得た。

[0 2 2 1] 1 H-NMR (400MHz, CDCl $_3$) :1.0-1.2(12H, m), 1.54(1H, m), 2.15(1H, m), 2.33(2H, m), 3.3-3.6(6 H, m), 3.80(6H, s), 4.08(2H, m), 4.65(1H, m), 4.75(1H, m), 6.53(1H, s), 6.84(4H, m), 7.2-7.6(12H, m), 8.01(2 H, m), 8.53(1H, s), 8.83(1H, s), 9.01(1H, brs). FAB-MAS (mNBA):900(M+H) $^+$

(実施例15)

50 <u>3',5'-ジ-O-ベンジル-2'-O,4'-C-エチレンウリジン</u>

(例示化合物番号2-10)

参考例 1 3 で得られた化合物 (194 mg、0.292 mm o l) を、ピリジン (3 m l) に溶解した。そこへ、1 N水酸化ナトリウム (2 m l) を 0℃で加え、室温で 3 0 分攪拌した。

【0222】反応終了後、1N塩酸で反応液を中和し、酢酸エチル(10ml)を加えて、分液し、有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーに 10より精製し(ジクロロメタン:メタノール=100:3)油状無色物質(105mg、0.233mmol,80%)を得た。

[0 2 2 3] ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.36 (1H, m), 2.29 (1H, m), 3.63 (1H, d, 11Hz), 3.74 (1H, d, 11Hz), 3.8 7 (1H, d, 2.9Hz), 4.03 (2H, m), 4.29 (1H, d, 2.9Hz), 4.49 (1H, d, 12Hz), 4.50 (1H, d, 11Hz), 4.53 (1H, d, 11Hz), 4.7 3 (1H, d, 12Hz), 5.20 (1H, dd, 2and 8Hz), 6.04 (1H, s), 7.2-7.4 (10H, m), 8.13 (1H, d, 8.2Hz), 8.57 (1H, brs). FAB-MAS (mNBA):451 (M+H) ⁺

(実施例16)

<u>2'-O,4'-C-エチレンウリジン</u>(例示化合物番号 2 - 1)

実施例 1 5 で得られた化合物 (100 mg、0.222 mm o l) をメタノール (4 m l) に溶解し、得られた 反応液を、水素気流下、常圧で 5 時間攪拌した。

【0224】反応終了後、触媒を濾過し、濾液の溶媒を減圧下留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール=10:1)、無色油状物質(45mg、0.167mm ol,75%)を得た。

[0 2 2 5] ¹H-NMR (400MHz, CD₃OD) : 1.35 (1H, dd, 4 and 13Hz), 2.13 (1H, ddd, 7, 11 and 13Hz), 3.66 (1H, d, 1 2Hz), 3.73 (1H, d, 12Hz), 3.91-4.08 (2H, m), 4.01 (1H, d, 3.2Hz), 4.12 (1H, d, 3.2Hz), 5.66 (1H, d, 8.2Hz), 6.00 (1 H, s), 8.37 (1H, d, 8.2Hz).

FAB-MAS (mNBA) : 271 (M+H) +

(実施例17)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレンウリジン</u>(例示化合物番号 2 - 1 5)

実施例16で得られた化合物(28mg、0.104mmol)を無水ピリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無水ピリジン(3ml)に溶解した。これに4.4'ージメトキシトリチルクロライド(50mg、0.15mmol)を添加し、室温で一晩攪拌した。反応溶液に少量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール=10

74 0:3)、無色油状の目的物(25mg、0.044m mol、42%)を得た。

[0 2 2 6] ¹H-NMR (400MHz, CD₃OD) : 1.35(1H, dd, 3 and 14Hz), 2.03(1H, ddd, 8.11 and 14Hz), 2.46(1H, d, 8Hz), 3.36(1H, d, 11Hz), 3.41(1H, d, 11Hz), 3.80(3H, s), 3.81(3H, s), 3.97(2H, m), 4.21(1), 4.33(1H, brm), 5.31(1H, m), 6.10(1H, s), 6.86(4H, m), 7.2-7.5(9H, m), 8.27(1H, d, 8.2Hz), 8.43(1H, brs), FAB-MAS (mNBA): 573(M+H) $^+$

(実施例18)

5'-Q-ジメトキシトリチル-2'-Q.4'-C-エチレンウリ ジン-3'-Q-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロ ピル) ホスホロアミダイト (例示化合物番号2-23 3)

実施例 17で得られた化合物(6 m g、0.0105 m mol)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流下、無水ジクロロメタン(0.5 ml)に溶解し、テトラゾールN,Nージイソプロピルアミン塩(3 m g)を加えた。氷冷下、2 ーシアノエチルN,N,N,Nーテトライソプロピルホスホロアミダイト(約5 μ l)を滴下し、室温で一晩攪拌した。反応溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:酢酸エチル=2:1)、白色固体の目的物(8 m g)を得た。

[0 2 2 7] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.1-1.2 (13H, m), 2.09 (1H, m), 2.4 (2H, m), 3.3-3.6 (6H, m), 3.81 (6 H, m), 3.94 (2H, m), 4.35 (1H, m), 4.47 (1H, m), 5.18 (1H, d, 8.2Hz), 6.08 (1H, s), 6.86 (4H, m), 7.2-7.4 (9H, m), 8.31 (1H, d, 8.2Hz). FAB-MAS (mNBA): 773 (M+H) $^+$

(実施例19)

3'.5'-ジ-O-ベンジル-2'-O.4'-C-エチレン-4-N-ベ ンゾイル-5-メチルシチジン (例示化合物番号 2 - 4 6)

参考例 1 4 で得られた化合物(3 1 0 mg、0.396 mmol)を、ピリジン(5 ml)に溶解し、0℃に冷却後、1 N水酸化ナトリウム水溶液(5 ml)を加え、室温で20分間撹拌した。反応後、反応液に20%酢酸水を滴下し、反応液を中和した後、ジクロロメタンで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。溶媒を減圧下留去した後、残渣をシリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール = 100:2)、目的化合物(190 mg、0.334 mmol、84%)を得た。

[0 2 2 8] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.37 (1H, m), 1.58 (3H, s), 2.30 (1H, dt. 10 and 13Hz), 3.64 (1H, d, 11Hz), 3.95 (1H, d, 3.0Hz), 4.04 (2H, dd, 2.3 and 10Hz), 4.37 (1H, d, 3.0Hz), 4.50 (1H, d, 12Hz), 4.56 (1H, d, 11Hz), 4.61 (1H, d, 11Hz), 4.76 (1H, d, 12Hz), 6.11 (1H, s), 7.2-7.5 (13H, m), 8.09 (1H, s), 8.29 (2H,

m).

FAB-MAS (mNBA) : 568 (M+H) +

(実施例20)

<u>2'-O, 4'-C-エチレン-4-N-ベンゾイル-5-メチルシ</u> <u>チジン</u>(例示化合物番号 2 - 2 2 6)

実施例19で得られた化合物(120mg、0.211 mmol)を無水ジクロロメタン(5ml)に溶解し、 - 78℃に冷却したところでトリクロロポラン(1.0 M in ジクロロメタン) (1.6 ml)を滴下した。-ゆっくり滴下し、10分間攪拌した後、炭酸水素ナトリ ウム飽和水溶液を少量ずつ加えてpH7~8に調整し、 室温に戻した。この混合溶液を減圧下濃縮し、得られた 残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製し (ジクロロメタン:メタノール=100:6)、白色固 体の目的物 (29mg、0.075mmol、36%)

 $[0\ 2\ 2\ 9]$ H-NMR (400MHz, d-DMSO) : 1.24 (1H, m), 2.01(3H, s), 2.0(1H, m), 3.54(1H, dd, 5.4 and 12Hz), 3.64(1H, dd, 5.4 and 12Hz), 3.88(3H, m), 4.10(1H, m), 5. 36 (1H, d, 5. 4Hz), 5. 49 (1H, t, 5. 0Hz), 5. 95 (1H, s), 7. 4-7.6(3H, m), 8.21(2H, m), 8.49(1H, s), 13.17(1H, br s). FAB-MAS (mNBA):388 (M+H) +

(実施例21)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O.4'-C-エチレン-4-</u> N-ベンゾイル-5-メチルシチジン (例示化合物番号 2 -51)

実施例20で得られた化合物(44mg、0.114m mol)を無水ピリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無 水ピリジン(1ml)に溶解した. ごれに4,4'ージ メトキシトリチルクロライド(60mg、0.177mmol)を添加し、室温で一晩攪拌した。反応溶液に少 量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、水を 加え、クロロホルムで抽出した。有機層を炭酸水素ナト リウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を減圧下 濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィ ーを用いて精製し(ジクロロメタン:メタノール=10 0:4)、無色油状の目的物(73mg、0.106m mol、93%) を得た。

[0 2 3 0] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.46 (1H, m), 1. 49 (3H, s), 2. 06 (1H, m), 2. 59 (1H, d, 8. 6Hz), 3. 36 (1 H, d, 11Hz), 3. 39 (1H, d, 11Hz), 3. 80 (3H, s), 3. 81 (3H, s), 3.99(2H,m), 4.30(1H,d, 3.3Hz), 4.39(1H,m), 6.1 2(1H, s), 6.85(4H, m), 7.2-7.5(12H, m), 8.03(1H, s), 8. 28 (2H, m).

FAB-MAS (mNBA) : 573 (M+H) +

(実施例22)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル - 2'-O, 4'-C-エチレン-4-</u> N-ベンゾイル-5-メチルシチジン-3'-O-(2-シア <u>ノエチル N, Nージイソプロピル) ホスホロアミダイ</u> 50 59(1H, qui, 6. 9Hz), 3. 54(1H, d, 11Hz), 3. 68(1H, d, 11H

76

上(例示化合物番号2-236)

実施例21で得られた化合物(35mg、0.0507 mmol)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流 下、無水ジクロロメタン(1m1)に溶解し、テトラゾー ルN, N-ジイソプロピルアミン塩(17mg)を加え た。氷冷下、2-シアノエチルN, N, 'N, 'N-テト ライソプロビルホスホロアミダイト (32μ1, 0.1 mmol)を滴下し、室温で一晩攪拌した。反応溶液を 炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄後、 78℃で4時間攪拌したあと、メタノール(1m1)を 10 溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲルクロ マトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン:酢酸 エチル=2:1)、白色固体の目的物(40mg、0. 0445mmol、89%) を得た。

[0 2 3 1] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃):1.1-1.2(12H, m), 1.36(3H,s), 1.37(1H,m), 2.10(1H,m), 2.36(2H, m), 3.3-3.6 (6H, m), 3.81 (6H, m), 3.98 (2H, m), 4.42 (1 H, m), 4.49 (1H, m), 6.11 (1H, s), 6.88 (4H, m), 7.2-7.5 (12H, m), 8. 14 (1H, s), 8. 28 (2H, m).

FAB-MAS (mNBA) :890 (M+H) +

(実施例23)

<u>2'-O,4'-C-エチレン-5-メチルシチジン</u>(例示化合 物番号2-226)

実施例 2 0 で得られた化合物 (11.6 mg、0.03 0 mm o 1) を飽和アンモニア-メタノール溶液 (2 m 1) に溶解し、一晩置いた。溶媒を留去して、白色固体 の目的物 (8.5mg、0.03mmol) を得た。 [0 2 3 2] 1 H-NMR (400MHz, d-DMSO) : 1.20(1H, m),

1.82(3H, s), 1.97(1H, m), 3.49(1H, dd, 5 and 12Hz), 3. 58 (1H, dd, 5 and 12Hz), 3.85 (2H, m), 5.23 (1H, d, 5Hz), 5. 32 (1H, t, 5Hz), 5. 84 (1H, s), 6. 7 (1H, brs), 7. 2 (1H, br s). 8.08(1H.s).

FAB-MAS (mNBA): 284 (M+H) $^+$ UV (λ max): 279 (pH7), 289 (pH1), 279 (pH13)

(実施例24)

3'.5'-ジ-O-ベンジル-2'-O.4'-C-エチレン-2-N-イ <u>ソブチリルグアノシン</u>(例示化合物番号1-24) 参考例15で得られた化合物(約200mg)を、ピリ ジン(2ml)に溶解した。そこへ、1N水酸化ナトリ ウム(2ml)を加え、室温で15分攪拌した。

40 【0233】反応終了後、1 N塩酸で反応液を中和し、 酢酸エチルで抽出し、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、 飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し た。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、シリカゲ ルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン: メタノール=50:1)、アモルファス状無色物質(2 0mg、0.036mmol、6%(2工程))を得

[0 2 3 4] ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.27(3H, s), 1. 29 (3H, s), 1. 43 (1H, dd, 3 and 13Hz), 2. 28 (1H, m), 2.

z), 4.03(2H, m), 4.15(1H, d, 3.0Hz), 4.31(1H, d, 3.0H z), 4.45(1H, d, 12), 4.56(1H, d, 12Hz), 4.61(1H, d, 12H z), 4.63(1H, d, 12Hz), 6.18(1H, s), 7.2-7.4(10H, m), 8. 19 (1H, s), 11. 93 (1H, brs). FAB-MAS (mNBA):560 (M+H) + (実施例25)

<u>2'-O.4'-C-エチレン-2-N-イソプチリルグアノシン</u> (例示化合物番号1-177)

実施例24で得られた化合物(10mg、0.018m mol) をメタノール(2ml) に溶解し、得られた反 応液を、水素気流下、常圧で5時間攪拌した。

【0235】反応終了後、触媒を濾過し、濾液の溶媒を 減圧下留去後、得られた残渣を、シリカゲルクロマトグ ラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール= 10:2)、無色油状物質(5mg、0.013mmo 1,72%)を得た。

[0 2 3 6] H-NMR (400MHz, CD₃OD) :1.21(3H, s), 1. 22(3H, s), 1.41(1H, dd, 4 and 13Hz), 2.18(1H, m), 2.6 9 (1H, qui, 6. 9Hz), 3. 69 (1H, d, 12Hz), 3. 76 (1H, d, 12Hz), 4. 0 (2H, m), 4. 26 (1H, d, 3. 2Hz), 4. 30 (1H, d, 3. 2Hz), 6. 30 (1H, s), 8. 40 (1H, s).

FAB-MAS (mNBA) : 380 (M+H) +

(実施例26)

5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-2-N-イソプチリルグアノシン (例示化合物番号1-3 5)

実施例25で得られた化合物(5mg、0.013mm o 1)を無水ビリジンで共沸脱水後、窒素気流下、無水 ピリジン(1ml)に溶解した. これに 4,4'ージメ トキシトリチルクロライド (14mg、0.04mmo 1)を添加し、40℃で3時間攪拌した。反応溶液に少 量のメタノールを加えた後、溶媒を減圧下濃縮し、得ら れた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精 製し(ジクロロメタン:メタノール=100:6)、無 色固体状の目的物(4mg、0.0059mmol、4 5%)を得た。

[0 2 3 7] ¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) :1, 26 (3H, d, 1, 4H) z), 1.28(3H, d, 1.4Hz), 1.66(1H, m), 2.15(1H, m), 2.59 (1H, qui, 6. 9Hz), 3. 65 (1H, m), 3. 78 (1H, m), 4. 06 (2H, m), 4.35(1H, m), 4.38(1H, d, 3.2Hz), 6.23(1H, s), 6.8 (4H, m), 7.2-7.5(9H, m), 8.01(1H, s), 8.19(1H, brs). F 40 AB-MAS (mNBA) : 682 (M+H) +

(実施例27)

<u>5'-O-ジメトキシトリチル-2'-O,4'-C-エチレン-2-</u> N-イソプチリルグアノシン-3'-O-(2-シアノエチ<u>ル N. N-ジイソプロピル) ホスホロアミダイト</u> (例 示化合物番号1-185)

実施例26で得られた化合物(4mg、0.0058m mol)を無水ピリジンで共沸脱水した後、窒素気流 下、無水ジクロロメタン(0.5ml)に溶解し、テトラ ゾールN, N-ジイソプロピルアミン塩(5mg)を加 50 体を合成し、合成サイクルの1)まで行い5-DMTr基

えた。氷冷下、2-シアノエチルN, N, 'N, 'N-テ トライソプロピルホスホロアミダイト(9μ1, 0.0 3mmol)を滴下し、室温で一晩攪拌した。反応溶液 を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗浄 後、溶媒を減圧下濃縮し、得られた残渣を、シリカゲル クロマトグラフィーを用いて精製し(ジクロロメタン: 酢酸エチルー2:1)、白色固体の目的物(4mg)を 得た。

78

[0 2 3 8] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃):1.1-1.4(19H, 10 m), 2.1 (1H, m), 2.4 (2H, m), 2.6 (1H, m), 3.3-3.6 (6H, m), 3.8(6H, s), 4.0-4.6(4H, m), 6.2(1H, s), 6.8(4H, m), 7.2-7.5(9H, m), 8.1(1H, s).

(実施例28)

2'-O.4'-C-エチレングアノシン(例示化合物番号1-

実施例25で得られた化合物(0.5mg)を、飽和ア ンモニア/メタノール溶液(0.5ml)に溶解し、6 0℃で5時間反応させた。

【0239】反応終了後、溶媒を減圧下留去し、白色粉 末(0.4mg)を得た。

[0.2 4 0] FAB-MAS (mNBA): 310 (M+H) + UV (λ max): 2 55 (pH7), 256 (pH1), 258-266 (pH13)

(実施例29)

(オリゴヌクレオチド類縁体の合成) 核酸合成機 (パー キンエルマー社製 ABI model392 DNA/RNA synthesise r) を用い、 $1.0 \mu mol スケールで行った。各合成サイク$ ルにおける溶媒、試薬、ホスホロアミダイトの濃度は天 然オリゴヌクレオチド合成の場合と同じであり、溶媒、 試薬、天然型ヌクレオシドのホスホロアミダイトは全て PE Biosystems社製のものを用いた。3'-水酸基がCPG支 持体に結合した5'-O-DMTr-チミジン(1.0 μ mo 1) のDMTァ基をトリクロロ酢酸によって脱保護し、 その5'-水酸基に天然ヌクレオチド合成用の4種の核酸 塩基からなるアミダイト及び実施例9の化合物を用いて 縮合反応を繰り返し行い、それぞれの配列の修飾オリゴ ヌクレオチド類縁体を合成した。合成サイクルは以下の 通りである。合成サイクル

- 1) detritylation トリクロロ酢酸/ジクロロメタン;35
- 2) coupling ホスホロアミダイト(約20eq)、テトラゾ ール/アセトニトリル; 25sec 又は 10min
 - 3) capping 1-メチルイミダゾール/テトラヒドロフラ ン、無水酢酸/ピリジン/テトラヒドロフラン;15sec
 - 4) oxidation ヨウ素/水/ピリジン/テトラヒドロフラ ン; 15sec上記において、サイクル2)は、実施例9の化 合物を用いて反応を行う場合は、10分間反応を行い、そ の他のホスホロアミダイトを用いる場合は25秒間反応を 行った。
 - 【0241】目的配列を有するオリゴヌクレオチド類縁

を脱保護した後は、常法に従い、濃アンモニア水処理に よってオリゴマーを支持体から切り出すとともに、リン 酸基上の保護基のシアノエチル基をはずし、さらにアデ ニン、グアニン、シトシンのアミノ基の保護基の脱保護 を行った。

【0242】得られたオリゴヌクレオチド類縁体は、逆 相HPLC (HPLC:島津製作所製LC-VP、カラム:和光純薬 製Wakopak WS-DNA) で精製を行い目的のオリゴヌクレオ チドを得た。

【0243】本合成法に従い、以下の配列:

5' - gcgttttttgct -3' (配列表の配列番号 2) で示される配列を有し、塩基番号4乃至9のチミジンの 糖部分が2'-O,4'-C-エチレンであるオリゴヌ クレオチド類縁体(以下、「オリゴヌクレオチド

(1)」とする。)を得た。(収量0.23μmol(23% yi eld))

(参考例1)

<u>3,5-ジ-O-ベンジル-4-トリフルオロメタンスルフォニ</u> <u>ルオキシメチル-1.2-O-イソプロピリデン-α-D-エリ</u> <u>スロペントフラノース</u>

窒素気流下、3.5-ジ-O-ベンジル-4-ヒドロキシメチル -1,2-O-イソプロピリデン-α-D-エリスロペントフラ ノース (2000mg、5.0mmol) を無水ジクロ ロメタン50mlに溶解し、-78℃に冷却した。そこ へ、無水ピリジン (0.60ml、7.5mmol)及 びトリフルオロメタンスルホン酸無水物(1010m g、6.0 mm o l) を加え、40 分間撹拌した。

【0244】反応終了後、反応液に、炭酸水素ナトリウ ム飽和水溶液(約100ml)を加え、分液し、有機層 を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約100ml)、飽 和食塩水(約100mlml)で洗浄し、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、白色粉末 (2520mg、4.73mmol, 95%) を得、こ れをそのまま次の反応に用いた。

[0 2 4 5] $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDCl₃) : 1.34(3H, s), 1.63(3H, s), 3.48(1H, d, 10Hz), 3.53(1H, d, 10Hz), 4. 21 (1H, d, 5. 0Hz), 4. 5 (4H, m), 4. 74 (1H, d, 12Hz), 4.80 (1H, d, 12Hz), 5.01 (1H, d, 12Hz), 5.73 (1H, d, 4.6Hz), 7.3(10H, m).

(参考例2)

<u>3, 5-ジ-O-ベンジル-4-シアノメチル-1, 2-O-イソプロ</u> ピリデン-α-D-エリスロペントフラノース

参考例1で得られた化合物(2520mg、4.73m mol)に、ジメチルスルホキシド(50ml)を加。 え、90℃で溶解した。室温に戻した後、シアン化ナト リウム (463mg、9.46mmol) を加え、50 ℃で3時間撹拌した。

【0246】反応終了後、反応液に、水(約100m 1)及び酢酸エチル(約100ml)を加え、分液し、 有機層を飽和食塩水(約100ml)で洗浄し、無水硫 50 FABMS(mNBA):415(M+H)+, [α]₀+57.4°(0.91, メタノ

酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得 られた残渣を、シリカゲルクロマトグラフィーにより精 製し(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)、無色油状物質 (1590mg、3.89mmol、82%)を得た。 [0 2 4 7] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.34(3H, s), 1.62 (3H, s), 2.88 (1H, d, 17Hz), 3.15 (1H, d, 17Hz), 3. 50 (1H, d, 10Hz), 3. 58 (1H, d, 10Hz), 4. 08 (1H, d, 5. 1Hz), 4. 52 (1H, d, 12Hz), 4. 56 (1H, d, 12Hz), 4. 57 (1H, m), 4.58(1H, d, 12Hz), 4.76(1H, d, 12Hz), 5.7 10 3(1H, d, 3.7Hz), 7.3(10H, m).

80

(参考例3)

3, 5-ジ-O-ベンジル-4-ホルミルメチル-1, 2-O-イソプ <u>ロピリデン-α-D-エリスロペントフラノース</u>

窒素気流下、参考例2で得られた化合物(610mg、 1. 49mmol) を、ジクロロメタン(10ml)に 溶解し、- 78℃に冷却した。そこへ、1.5Mジイソ ブチルアルミニウムハイドライド/トルエン溶液 (2 m 1、3.0mmol)をゆっくり滴下して、-78℃で 1時間撹拌した。その後、室温に戻し、反応液にメタノ ール(5ml)を加えた、さらに、飽和塩化アンモニウ ム水溶液(約20ml)を加えて、30分撹拌した。

【0248】反応終了後、反応液に、酢酸エチル(約3 0ml)を加え、分液し、有機層を炭酸水素ナトリウム 飽和水溶液(約30ml)、次いで、飽和食塩水(約3 0 m l) で洗い、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減 圧下、溶媒を留去後、これをそのまま次の反応に用い

(参考例4)

3,5-ジ-〇-ベンジル-4-ヒドロキシエチル-1,2-〇-イソ プロピリデン-α-D-エリスロペントフラノース 参考例3で得られた化合物(154mg、0.377m mol)を、エタノール5mlに溶解し、NaBH 4(7.6mg、0.2mmol)を加え、室温で1時 間撹拌した。

【0249】反応終了後、反応液に、酢酸エチル(約1 0ml)及び水(約10ml)を加え、分液し、有機層 を飽和食塩水(約10ml)で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥した。

【0250】減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、 40 シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ヘキサ ン:酢酸エチル=2:1)、無色油状物質(117m g、0.284mmol、75%) を得た。

[0 2 5 1] H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.33(3H, s), 1.66 (3H, s), 1.78 (1H, ddd, 4.0, 8.5, 15Hz), 2.51 (1 H, ddd, 3.4, 6.4, 15Hz), 3.31(1H, d, 10Hz), 3.54(1 H, d, 10Hz), 3.80(2H, m), 4.13(1H, d, 5.3Hz), 4.43 (1H, d, 12Hz), 4.52(1H, d, 12Hz), 4.55(1H, d, 12H z), 4.65(1H, dd, 4.0, 5.3Hz), 4.77(1H, d, 12Hz), 5. 77 (1H, d, 4.0 Hz). 7.3 (10H, m).

ール).

(参考例5)

3, 5-ジ-O-ベンジル-4-ホルミル-1, 2-O-イソプロピリ デン-α-D-エリスロペントフラノース

窒素気流下、-78℃に冷却した無水ジクロロメタン (200ml)に、塩化オキサリル(6.02ml、6 9.0mmol)を加え、そこへ、無水ジクロロメタン (100ml) に溶解したジメチルスルホキシド (7. 87ml、110mmol)を滴下した。20分攪拌 後、反応試薬液に無水ジクロロメタン(100ml)に 溶解した3,5-ジ-〇-ベンジル-1,2-〇-イソプロピリデン $-\alpha$ -D-エリスロペントフラノース(9210mg、2 3. 02mmol)を滴下し、さらに、30分攪拌し た。さらにまた、トリエチルアミン(28ml、200 mmol)を加え、ゆっくり室温に戻した。反応液に水 (約300ml)を加え、分液し、有機層を水(約30 0ml)、飽和食塩水(約300ml)で洗い、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、シ リカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ヘキサン: 酢酸エチル=5:1)、無色油状物質(8310mg、 20.88mmol,91%)を得た。

(参考例6)

3.5- ジ-O-ベンジル-4-ビニル-1.2-O-イソプロピリデ <u>ン-α-D-エリスロベントフラノース</u>

窒素気流下、参考例 5 で得られた化合物 (8310 mg、20.88 mmol)を無水テトラヒドロフラン (300 ml)に溶解し、0℃に冷却した。そこへ、0.5 Mーテーベ試薬/トルエン溶液 (44 ml、22 mmol)を滴下後、0℃で1時間攪拌した。

【0253】反応終了後、ジエチルエーテル(300ml)を加えた後、0.1N水酸化ナトリウム水溶液(20m)をゆっくり加えた。得られた析出物をセライトを用いて濾過し、濾取物をジエチルエーテル(約100ml)で洗い、分液し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣をアルミナ(塩基性)クロマトグラフィーにより粗精製し(ジクロロメタン)、さらに、得られた粗精製物をシリカゲルクロマトグラフィーによりさらに精製し(ヘキサン:酢酸エチル=8:1、その後、5:1)、無色油状物質(5600mg、14.14mmol,68%)を得た。

[0 2 5 4] 'H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.28(3H, s), 1.52(3H, s), 3.31(1H, d, 11Hz), 3.34(1H, d, 11Hz),

4. 25 (1H, d, 4. 9Hz), 4. 40 (1H, d, 12Hz), 4. 52 (1H, d, 12Hz), 4. 57 (1H, dd, 3. 9, 4. 9Hz), 4. 59 (1H, d, 12Hz), 5. 25 (1H, dd, 1. 8, 11Hz), 5. 52 (1H, dd, 1. 8, 18Hz), 5. 76 (1H, d, 3. 9Hz), 6. 20 (1

82

H, dd, 11, 18Hz), 7.3 (10H, m). FABMS (mNBA) : 419 (M +Na) +.

(参考例7)

3,5-ジ-O-ベンジル-4-ヒドロキシエチル-1,2-O-イソプロピリデン-α-D-エリスロベントフラノース

窒素気流下、参考例6で得られた化合物(5500mg、13.89mmol)を無水テトラヒドロフラン(200ml)に溶解し、そこへ、0.5Mの9-BBN(9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン)/テトラヒドロフラン溶液(80ml、40mmol)を滴下し、室温で一晩攪拌した。

【0255】反応液に泡が出なくなるまで水を加えた後、3N水酸化ナトリウム水溶液(30ml)を加えた。さらに、30%過酸化水素水(30ml)を、反応液が30万至50℃になるようにゆっくり加え、その後30分攪拌した。

【0256】反応終了後、反応混合物に、飽和食塩水(約200ml)及び酢酸エチル(約200ml)を加え、分液し、有機層を中性リン酸バッファー(約200ml)で洗い、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ペキサン:酢酸エチル=2:1、その後、1:1)、無色油状物質(5370mg、12.97mmol, 93%)を得た。

1. 66 (3H, s), 1. 78 (1H, ddd, 4.0, 8.5, 15Hz), 2. 51 (1 H, ddd, 3.4, 6.4, 15Hz), 3. 31 (1H, d, 10Hz), 3. 54 (1 H, d, 10Hz), 3. 80 (2H, m), 4. 13 (1H, d, 5. 3Hz), 4. 43 (1H, d, 12Hz), 4. 52 (1H, d, 12Hz), 4. 55 (1H, d, 12Hz), 4. 65 (1H, dd, 4.0, 5. 3Hz), 4. 77 (1H, d, 12Hz), 5. 77 (1H, d, 4.0 Hz), 7. 3 (10H, m). FABMS (mNBA): 415 (M+H) +, $[\alpha]_D$ +57. 4° (0.91, $\forall \beta \not \supset \neg \nu$).

(参考例8)

3,5-ジ-O-ベンジル-4-(p-トルエンスルホニルオキシ エチル)-1,2-O-イソプロピリデン-α-D-エリスロベン トフラノース

窒素気流下、トルエン共沸した参考例 4 で得られた化合物(1035mg、2.5mmol)を無水ジクロロメタン(35ml)に溶解し、0℃に冷却した。そこへ、トリエチルアミン(1.8ml、13mmol)、ジメチルアミノビリジン(30mg、0.25mmol)、塩化pートルエンスルホニル(858mg、4.5mmol)を加え、室温で一晩攪拌した。

【0258】反応終了後、反応液に炭酸水素ナトリウム 50 飽和水溶液(約100ml)を加え、分液し、有機層 を、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約100ml)、 飽和食塩水(約100ml)で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥した。

【0259】減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、 シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ヘキサ ン:酢酸エチル=3:1)、無色油状物質(1340m g、2.6mmol,94%)を得た。

[0 2 6 0] 1H-NMR (400MHz, DCl₃): 1.33(3H, s), 1.49(3H, s), 1.99(1H, dt, 7.6 and 15 Hz), 2.47(3H, s), 2.60(1H, ddd, 5.7, 7.6, 15Hz), 3.28(1H, d, 10H z), 3. 45 (1H, d, 10Hz), 4. 11 (1H, d, 5. 3Hz), 4. 32 (2H, m), 4.42(1H, d, 12Hz), 4.50(1H, d, 12Hz), 4.54(1 H, d, 12Hz), 4.62 (1H, dd, 4.0, 5.2Hz), 4.76 (1H, d. 12Hz), 5.74 (IH, d, 4.0 Hz), 7.3 (12H, m), 7.78 (2H, d, 8.3Hz). FAB-MAS (mNBA):569 (M+H) + (参考例9)

1, 2-ジ-O-アセチル-3, 5-ジ-O-ベンジル-4-(p-トルエ <u>ンスルホニルオキシエチル)-α-D-エリスロペントフラ</u>

参考例 8 で得られた化合物 1 3 4 0 mg (2.36 m 20 mol)を酢酸15mlに溶解し、無水酢酸1.88m (20mmol)、濃硫酸0.01mlを加え、室 温で1時間攪拌した。反応液を氷冷水60mlにあけ、 さらに30分攪拌した。飽和食塩水(約100ml)、 酢酸エチル(約100ml)を加え、有機層を中性リン 酸バッファー、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食 塩水で洗い、硫酸マグネシウム無水物で乾燥した。溶媒 を留去後、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィ ーにより精製し(ヘキサン:酢酸エチル = 2: 1)、無色油状物質 1290mg(2.11mmo 89%、 $\alpha:\beta=1:5$)を得た。

【0 2 6 1】 1H-NMR (400MHz, CDC13): (8体) 1.86 (3H, s), 2.05(3H, s), 2.08(1H, m); 2.18(1H, m), 2. 42(3H, s), 3.30(1H, d, 10Hz), 3.33(1H, d, 10Hz), 4.23(1H, d, 5.1Hz), 4.24(2H, m), 4.42(2H, s), 4.45 (1H, d, 12Hz), 4.55(1H, d, 12Hz), 5.28(1H, d, 5.1H z), 6.01(1H, s), 7.3 (12H, m), 7.73(2H, d, 8.3Hz). FAB-MAS (mNBA) :613 (M+H) +

(参考例 10)

<u>2'-O-アセチル-3',5'-ジ-O-ベンジル-4'-p-トルエン</u> <u>スルホニルオキシエチル-5ーメチルウリジン</u> 窒素気流下、室温で参考例9で得られた化合物(650 mg、1.06mmol)を無水1,2-ジクロロエタ ン (15ml) に溶解し、そこに、前記の文献 (H. Vorbrggen, K. Krolikiewicz and B, Bennua, Chem. Ber., 1 14,1234-1255 (1981)) に従って調製 したトリメチルシリル化チミン(500mg、約2mm 01)を加えた。さらに、そこへ、トリフルオロメタン スルホン酸トリメチルシリル (0.36ml、2mmo 50 FAB-MAS (mNBA):768 (M+H) *

1)を滴下し、50℃で一時間攪拌した。

【0262】反応終了後、反応液に炭酸水素ナトリウム 飽和水溶液(約50ml)を加え、セライトを用いてろ 過し、濾液にジクロロメタン(約50ml)を加え、有 機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約50m1)、 飽和食塩水(約50ml)で洗浄後、無水硫酸マグネシ ウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣 をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ヘキサ ン:酢酸エチル=1.2:1)、アモルファス状無色物 10 質(432mg、0.64mmol、60%)を得た。 [0 2 6 3] 'H-NMR (400MHz, CDCl₃): 1.52(3H, d, 0.9Hz), 1.94(1H, dt, 7.5 and 15Hz), 2.06(3H, s), 2. 23 (1H, dt, 6.0 and 15Hz), 2. 42 (3H, s), 3. 38 (1H, d, 10Hz), 3.67(1H, d, 10Hz), 4.17(2H, m), 4.36(1H, d, 6.0Hz), 4.41(1H, d, 12Hz), 4.44(1H, d, 12Hz), 4. 48 (1H, d, 12Hz), 4. 58 (1H, d, 12Hz), 5. 39 (1H, dd, 5. 1 and 6. 0Hz), 6. 04(1H, d, 5. 1Hz), 7. 3 (12H, m), 7. 73 (2H, dt, 1.8 and 8. 3Hz), 8. 18 (1H, s). FAB-MAS (m NBA):679 (M+H)+

84

(参考例11)

2'-O-アセチル-3',5'-ジ-O-ベンジル-4'-p-トルエン <u>スルホニルオキシエチル-4-N-ベンゾイルシチジン</u> 参考例9で得られた化合物(383mg、0.626m mol) を、無水1, 2-ジクロロエタン(4ml) に 溶解した。そこへ、前記の文献(H. Vorbrgge n, K. Krolikiewicz and B, Be nnua, Chem. Ber., 114, 1234-1 255(1981))に従って調製したトリメチルシリ ル化ペンゾイルシトシン (300mg、約1.0mmo 1)を加え、0℃に冷却し、さらに、トリフルオロメタ ンスルホン酸トリメチルシリル(0.18ml、0.9 95mmol)を加え、その後、50℃で1時間撹拌し た。反応液を、室温に戻し、飽和炭酸水素ナトリウム水 溶液(約10ml)を加えた。

【0264】反応終了後、反応混合物に塩化メチレン (約20ml)を加えて、攪拌し、析出した白色不溶物 をセライトを用いて濾過した。得られた濾液から有機層 を分離し、有機層を飽和食塩水(約20ml)で洗浄 し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を 留去し、無色アモルファス状物質(397mg、83 %)を得た。

[0 2 6 5] $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDCl₃) : 8.70(1H, br), 8. 18 (1H, d, 7. 4Hz), 7. 87 (2H, d, 7. 5Hz), 7. 72 (2H, d, 8. 3Hz), 7. 61-7. 57 (1H, m), 7. 51-7. 48 (2H, m), 7. 43-7. 21 (13H, m), 6. 02 (1H, d, 2. 9Hz), 5. 40 (1H, dd, 5. 8, 2.9Hz), 4.57(1H, d, 11Hz), 4.39(1H, d, 11Hz), 4.3 2-4. 28 (3H, m), 4. 19-4. 16 (2H, m), 3. 69 (1H, d, 11Hz), 3. 31 (1H, d, 11Hz), 2. 40 (3H, s), 2. 30-2. 23 (1H, m), 2.06(3H, s), 1.95-1.89(1H, m)

(参考例12)

【0266】反応終了後、反応液に炭酸水素ナトリウム 飽和水溶液(約50ml)を加え、さらにジクロロメタ ン(約50ml)を加えて、分液し、有機層を炭酸水素 ナトリウム飽和水溶液(約50ml)、次いで、飽和食 塩水(約50ml)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで 乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣を、シ リカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメ タン:メタノール=50:1)、アモルファス状無色物 質(405mg、0.51mmol,52%)を得た。 [0 2 6 7] $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDCl₃) : 2.0(1H, m), 2.06(3H, s), 2.32(1H, dt, 6.0 and 15Hz), 2.40(3H, s), 3.36(1H, d, 10Hz), 3.58(1H, d, 10Hz), 4.22(2H, m), 4.39(1H, d, 12Hz), 4.45(1H, d, 12Hz), 4.47(1H, d, 12Hz), 4.59(1H, d, 12Hz), 4.62(1H, d, 5.6Hz), 5.94 (1H, dd, 4.5 and 5.6Hz), 6.21 (1H, d, 4.5Hz), 7. 2-7.3 (12H, m), 7.54 (2H, m), 7.62 (1H, dt, 1.2 and 6. 2Hz), 7. 72 (2H, d, 8. 3Hz), 8. 02 (2H, m), 8. 21 (1H, s), 8.75(1H, s), 8.97(1H, brs). FAB-MAS(mNBA):792 $(M+H)^+$

(参考例13)

2'-O-アセチル-3'.5'-ジ-O-ベンジル-4'-p-トルエン スルホニルオキシエチル-ウリジン

窒素気流下、室温で参考例9で得られた化合物(200 mg、0.327mmol)を無水1,2ージクロロエタン(8ml)に溶解し、そこに、前記の文献(H. Vorbrggen, K. Krolikiewiczand B, Bennua, Chem. Ber., ll4,1234-1255(1981))に従って調製したトリメチルシリル化ウラシル(200mg、約0.8mmol)を加えた。さらに、そこへ、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル(0.145ml、0.8mmol)を滴下し、70℃で一時間攪拌した。、【0268】反応終了後、反応液に炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(約10ml)を加え、セライトを用いてろ過し、濾液にジクロロメタン(約10ml)を加え、有機層を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液、飽和食塩水で洗

浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去後、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し(ジクロロメタン:メタノール=100:2)、油状無色物質(199mg、0.299mmol、92%)を得た。

86

[0 2 6 9] 'H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.94 (1H, dt, 7.4 and 15Hz), 2.07 (3H, s), 2.23 (1H, dt, 5.9 and 15Hz), 2.43 (3H, s), 3.36 (1H, d, 10Hz), 3.65 (1H, d, 10Hz), 4.17 (2H, dd, 6 and 7Hz), 4.31 (1H, d, 5.9Hz), 4.38 (1H, d, 11Hz), 4.39 (1H, d, 11Hz), 4.40 (1H, d, 11Hz), 4.58 (1H, d, 11Hz), 5.29 (1H, dd, 2.4 and 8.2Hz), 5.33 (1H, dd, 4.5 and 6Hz), 6.00 (1H, d, 4.5 Hz), 7.2-7.4 (12H, m), 7.61 (1H, d, 8.2Hz), 7.74 (1H, d, 8.3Hz), 8.14 (1H, brs). FAB-MAS (mNBA):665 (M+H) $^+$

(参考例14)

2'-O-アセチル-3',5'-ジ-O-ベンジル-4'-p-トルエン スルホニルオキシエチル-4-N-ベンゾイル-5-メチルシ チジン

参考例 9 で得られた化合物(400 mg、0.653 m mol)を、無水1, 2-ジクロロエタン(6 ml)に溶解した。そこへ、前記の文献(H. V or b rggen, K. K rolikiewicz and B, B ennua, C hem. B er., 114, 1234-1255 (1981))に従って調製したトリメチルシリル化ペンゾイル5-メチルシトシン(約400 mg、約1.2 mmol)を加え、0 $\mathbb C$ に冷却し、さらに、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル(180μ 1、1.0 mmol)を加え、その後、50 $\mathbb C$ で1時間撹拌した。反応液を、室温に戻し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(約5 ml)を加えた。

【0270】反応終了後、反応混合物に塩化メチレン (約10ml)を加えて、攪拌し、析出した白色不溶物をセライトを用いて濾過した。得られた濾液から有機層を分離し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下、溶媒を留去し、無色アモルファス状物質(320mg、0.409mmol、63%)を得た。

[0 2 7 1] 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃) : 1.68 (3H, s), 1.95 (1H, dt, 7.3 and 15Hz), 2.07 (3H, s), 2.25 (1H, dt, 6 and 15Hz), 2.43 (3H, s), 3.40 (1H, d, 10Hz), 3.71 (1H, d, 10Hz), 4.18 (2H, m), 4.37 (1H, d, 5.8Hz), 4.42 (1H, d, 12Hz), 4.46 (1H, d, 12Hz), 4.51 (1H, d, 12Hz), 4.61 (1H, d, 12Hz), 5.42 (1H, dd, 4.9 and 5.8Hz), 6.07 (1H, d, 4.9Hz), 7.2-7.6 (17H, m), 7.74 (2H, d, 8.3Hz), 8.28 (2H, d, 7.0Hz). FAB-MAS (mNBA) :782 (M+H) $^{+}$

(参考例15)

2'-O-アセチル-3',5'-ジ-O-ベンジル-4'-p-トルエン スルホニルオキシエチル-2-N-イソブチリルグアノシン 窒素気流下、室温で、参考例 9 で得られた化合物 (400 50 mg、0.65mmol)を、無水1,2-ジクロロエタン (10ml) に溶解し、そこに、前記の文献(H. Vorbrggen, K. Krolikiewicz and B, Bennua, Chem. Ber., 114, 1234-1255(1981)) に従って調製したトリメチルシリル化イソブチリルグアノシン(約650mg、約1.5mmol)を加えた。得られた反応液に、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル(0.2ml、1.2mmol)を滴下後、50℃で4時間攪拌した。

【0272】反応終了後、反応液に炭酸水素ナトリウム 飽和水溶液(約5ml)を加え、分液し、有機層を炭酸 水素ナトリウム飽和水溶液、次いで、飽和食塩水で洗浄 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去後、 そのままこれを次の反応に用いた。

(試験例1)

(Tm測定試験) 最終濃度をそれぞれ、NaCl 10 0mM、リン酸ナトリウム緩衝液(pH7.2) 10m M、オリゴヌクレオチド(1) $4\mu M$ 、その相補鎖(配列:

5'- agcaaaaacgc -3' (配列表の配列番号 1) で示される配列を有する相補型DNA(以下、「オリゴ 20 ヌクレオチド(2)」とする。)又は配列: 5'- agcaaaaacgc -3' (配列表の配列番号 1) で示される配列を有する相補型RNA(以下、「オリゴ ヌクレオチド(3)」とする。))4μMとしたサンプ**

*ル溶液(1000 μ L)を沸騰水中に浴し、約2時間をかけてゆっくり室温まで冷却した。サンプル溶液を、分光光度計(島津 UV-3100PC)を用いて加温測定した。サンプルはインキュベーター(EKO社製、Haake FE2)で加温した循環水によりセル(セル厚1.0cm、円筒ジャケット型)内を加温し、温度はデジタル温度計(SATO SK1250MC)を使用してモニターした。温度は20℃から95℃まで上昇させ、1℃間隔で260nm付近の吸収極大波長における紫外吸収強度を測定した。コントロールとしてオリゴ10 ヌクレオチド(1)(実施例29の化合物)と同じ配列:

88

5'- gcgttttttgct -3' (配列表の配列番号 2) で示される配列を有する天然型 DNA (以下、「オリゴヌクレオチド(4)」とする。)を用い、同様の操作を行った。

【0273】1℃あたりの変化量が最大になる温度をTm (融解温度)とし、この温度でオリゴヌクレオチド類縁体の相補鎖形性能を評価した。以下に、オリゴヌクレオチド(4)(天然型DNA)及びオリゴヌクレオチド

- (1) (実施例29の化合物)のオリゴヌクレオチド
- (2) (相補型DNA) 及びオリゴヌクレオチド(3)(相補型RNA) に対するTm測定結果を示す。

[0274]

【表3】

Tm (℃)		
化合物	オリゴヌクレオチド(2)	オリゴヌクレオチド (3)
オリゴヌクレオチド	(4) 48	4 4
オリゴヌクレオチド	(1) 61	7 5

上記より明らかなように、本発明のオリゴヌクレオチド 類縁体は、天然型DNAと比べて顕著にTmが高く、高い相 補鎖形性能を示した。

(試験例2)

(ヌクレアーゼ酵素耐性の測定) 15分間37℃に保ったオリゴヌクレオチドのバッファー溶液にエキソヌクレアーゼ若しくはエンドヌクレアーゼを混合する。混合液を37℃に保ち、一定時間後、混合液の一部を取り、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)を加え、100℃で2分間加熱することにより、反応を停止させる。混合液中のオリゴヌクレオチドの残量を逆相高速液体カラムクロマトグラフィーで定量し、ヌクレアーゼ存在下でのオリゴヌクレオチド量の経時的変化を測定する。

【0275】本発明のオリゴヌクレオチド類縁体は顕著※

※なヌクレアーゼ耐性を示す。

[0 2 7 6]

【発明の効果】本発明の新規なヌクレオチド類縁体及び ヌクレオシド類縁体は、安定で優れたアンチセンス若し くはアンチジーン医薬、特定遺伝子の検出薬(プロー ブ)又は増幅開始の為のプライマー及びその製造中間体 として有用である。

[0277]

40 .【配列表フリーテキスト】

配列番号1: Tm値測定用の合成オリゴヌクレオチド 配列番号2: Tm値測定用の合成オリゴヌクレオチド

【0278】

SEQUENCE LISTING

<110> Sankyo Company, Limited

<120> Novel Nucleoside and Nucleotide Derivatives

<130> 99172SL

<140>

```
(45)
                    89
                                                                       90
                <141>
                <150> JP HEI11-33863
                <151> 1999-02-12
                <160> 2
                <170> PatentIn Ver. 2.0
                <210> 1
                <211> 12
                <212> DNA
                <213> Artificial Sequence
                <220>
                <223> Description of Artificial Sequence: Synthesized
                     oligonucleotide for testing Tm varue
                <400> 1
                                                                           12
                agcaaaaaac gc
                <210> 2
                <211> 12
                <212> DNA
                <213> Artificial Sequence
                <220>
                <223> Description of Artificial Sequence: Synthesized
                     oligonucleotide for testing Tm varue
                                                                           12
                gcgttttttg ct
フロントページの続き
                                                  FΙ
  A 6 1 P 43/00
                                                  A 6 1 P 43/00
  C 1 2 N 15/09
                                                  C 1 2 N 15/00
                                                                          ZNAA
                       ZNA
                                                  (58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, DB名)
             特開 平10-304889 (JP, A)
             特表2002-521310 (JP, A)
                                                              CO7H 19/00 - 21/04
              Tetrahedron Lette
                                                              REGISTRY (STN)
                                                              CA (STN)
            rs, 1998年, Vol. 39, p. 5401-
            5404
                                                              CAOLD (STN)
              Chem. Commun., 1998年,
```

(51) Int. Cl. 7

(56)参考文献

p. 455-456

l. 54, p. 3607-3630

Tetrahedron, 1998年Vo